



สัญญาเลขที่ R2558C066

สำนักหอสมุด

อภินันทนาการ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประดิษฐ์เซรามิก BNKLLT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไฟฟ้า
Low Temperature Fabrication of Lead-Free BNKLLT Ceramics via the
Combustion Technique

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย บงกชาน
ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันลงทะเบียน 25.๘.๒๕๕๙
เลขประจำตัว 16910531
เลขเรียกหนังสือ ๑๐๓ ๗๖๗

๑๖๓

๒๕๔

สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อวิจัย

การประดิษฐ์เซรามิก BNKLLT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาใหม่

นักวิจัย

ผศ.ดร.ธีระชัย บงกชารณ์

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของการเผาที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของผง ผลึกและเซรามิก $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.68}\text{K}_{0.22}\text{Li}_{0.1})_{0.5}\text{TiO}_3$ ซึ่งเติม La_2O_3 ปริมาณ 0.1 wt% (BNKLLT) ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่ (combustion) ใช้ไกลเซ็นเป็นเชื้อเพลิงในอัตราส่วน 1:0.56 แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600-900°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075-1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เฟสเดี่ยวเพอร์อฟไกเต้แบบรวมโดยชีดรัลที่บริสุทธิ์ ได้จากผงผลึก BNKLLT ที่แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เซรามิก BNKLLT แสดงโครงสร้างเฟสเพอร์อฟไกเต้ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง โครงสร้างจุลภาคของผงผลึก BNKLLT แสดงลักษณะค่อนข้างกลมและเกาะกลุ่มกันหนาแน่น ในขณะที่เกรนเซรามิกมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ขนาดอนุภาคเฉลี่ยและเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์และซินเตอร์เพิ่มขึ้น ความหนาแน่น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ϵ_r และ ϵ_m), P_r และ d_{33} มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นถึง 1100°C จากนั้นลดลง ความหนาแน่นสูงสุดมีค่า 5.73 g/cm² ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดมีค่าเป็น ($\epsilon_r \sim 2572$ และ $\epsilon_m \sim 5536$) สมบัติเพอร์โอดิอิเล็กทริกที่ดี ($P_r \sim 35.78 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ และ $E_c \sim 22.42 \text{kV}/\text{cm}$) และค่าคงที่โพอิโซอิเล็กทริกสูงสุด (d_{33}) เป็น 210 pC/N ได้จากการตัวอย่างที่ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

Research Topic: Low Temperature Fabrication of Lead-Free BNKLLT Ceramics via the Combustion Technique

Researcher: Assist. Prof. Dr.Theerachai Bongkarn

ABSTRACT

The effect of firing temperatures on phase formation, microstructure and physical properties of $[Bi_{0.5}(Na_{0.68}K_{0.22}Li_{0.1})_0.5TiO_3]$ doped with La_2O_3 at 0.1 wt% (BNKLLT) ceramics prepared by the combustion method was studied. Glycine was used as fuel and the ratio of raw material (corresponding oxidant metal nitrate) with fuel was about 1:0.56. The samples were calcined at $600\text{-}900^\circ C$ for 2 h and sintered at $1075\text{-}1150^\circ C$ for 2 h. The single rhombohedral perovskite phase of BNKLLT powders was observed from the sample calcined at $750^\circ C$ for 2 h. The BNKLLT ceramics exhibited a pure perovskite phase in all samples. The microstructures of the BNKLLT powders exhibited an agglomerated form while the grain ceramics exhibited a square shape. The average particle size and average grain size increased with increasing firing temperatures. The density, dielectric constant (ϵ_r and ϵ_m), P_r and d_{33} tended to increase with increasing sintering temperatures up to $1100^\circ C$ and then decreased. The maximum density (5.73 g/cm^3), maximum dielectric constant ($\epsilon_r \sim 2572$ and $\epsilon_m \sim 5536$), good ferroelectric properties ($P_r \sim 35.78 \mu\text{C/cm}^2$ and $E_c \sim 22.42 \text{ kV/cm}$) and highest d_{33} (210 pC/N) were obtained by the sample sintered at $1100^\circ C$ for 2 h.

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

บิสมัทโซเดียมไททาเนต $[(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{TiO}_3; \text{BNT}]$ เป็นวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการนำมาใช้ทดแทนเซรามิกที่มีตัวถ่วงเป็นส่วนประกอบโดยเซรามิกดังกล่าวมีการเปลี่ยนโครงสร้างเฟสสองช่วง คือเปลี่ยนจากรومโบฮีดรัลแอนติเฟรโรอิเล็กทริกเป็นเทหะรโคนัลเฟรโรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟส (T_d) และจะเปลี่ยนโครงสร้างเฟสจากเทหะรโคนัลเฟรโรอิเล็กทริกเป็นคิวบิกพาราอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรี (T_c) [1-3] นอกจากนี้เซรามิกมีอุณหภูมิคูรีที่สูง ($T_c = 320^\circ\text{C}$) และมีค่าสภาพขั้วคงค้างที่ดี ($P_r = 38 \mu\text{C/cm}^2$) อย่างไรก็ตามเซรามิก BNT มีค่าสนามลบล้างที่สูงมาก ($E_c = 73 \text{ kV/cm}$) และมีค่า d_{33} ที่ต่ำ การนำไปอ่อน化 เช่น K^+ และ Li^+ แทนที่ Na^+ ใน A-site [4-11] สามารถลดค่าสนามลบล้างและเพิ่มค่า d_{33} ให้สูงขึ้นได้

เมื่อไনานนานนี้ Hong Pan และคณะ [11] เตรียมเซรามิก $[\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.68}\text{K}_{0.22}\text{Li}_{0.1})_{0.5}\text{TiO}_3; \text{BNKLT}]$ โดยเจือ La_2O_3 ปริมาณต่างๆ ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง พบว่าเมื่อเจือ La_2O_3 ปริมาณ 0.1 wt% เซรามิก BNKLT แสดงสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีโดยมีค่า $d_{33}=192 \text{ pC/N}$, $\varepsilon_r=1254$ (1 kHz), $\tan\delta=0.0483$, $P_r=29.1 \mu\text{C/cm}^2$ และ $E_c=29.0 \text{ kV/cm}$ อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ผงผลึก BNKLT ที่เจือ La_2O_3 (BNKLLT) ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งต้องใช้อุณหภูมิในการแคลใจน์สูง (850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง) และเป็นที่ทราบกันดีว่าการสังเคราะห์ผงผลึกด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งเป็นวิธีที่จ่าย แต่ต้องใช้อุณหภูมิในการเตรียมสูง นอกจากนี้ผงผลึกที่เตรียมได้มีขนาดใหญ่และขนาดอนุภาคมีกระจายตัว กว้าง [12] เมื่อเร็วๆ คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการเตรียมเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิต่ำและมีความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการเผาใหม่ [13] ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นเทคนิคที่มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก เตรียมสารได้ในปริมาณครั้งละมากๆ และใช้ต้นทุนต่ำ ทั้งนี้วิธีการเผาใหม่ เป็นวิธีที่อาศัยการปลดปล่อยพลังงานที่ได้จากการจุดระเบิดซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของเชื้อเพลิง เช่น ยูเรีย (urea) เอกซ์เมทธิลเททระมีน (hexamethyltetra-mine) และ ไกลซีน (glycine) เป็นต้น พลังงานที่ได้จากการจุดระเบิดนี้ช่วยให้อุณหภูมิในการเผาสารลดลง จึงทำให้ประหยัดพลังงานอย่างมาก และเทคนิคการเผาใหม่นี้ยังเป็นวิธีเดียวในการเตรียมผงผลึกที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารตั้งต้นในระดับโนเบกูลอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผงผลึกที่ได้มีคุณภาพดี มีองค์ประกอบทางเคมีตามที่ต้องการ และมีขนาดอนุภาคเคลื่อนที่ในระดับนาโน [12-14] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อโครงสร้างผงผลึก โครงสร้างจุลภาค

และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก $[Bi_{0.5}(Na_{0.68}K_{0.22}Li_{0.1})_{0.5}TiO_3]$ ที่เติม La_2O_3 ปริมาณ 0.1 wt% (BNKLLT) ซึ่งเตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและผลของอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกและเซรามิกบิสมัทโดยเดิมโพแทสเซียมไททาเนตที่เจือแลนทาล์มอกไซด์ปริมาณ 0.1 wt % ด้วยเทคนิคการเผาใหม่ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการเตรียมผงผลึกที่มีคุณภาพสูงแต่ใช้ต้นทุนในการเตรียมต่ำรวมทั้งศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและผลของอุณหภูมิชิ้นเตอร์ที่ใช้ในปฏิกริยาการเผาซึ่งที่มีผลต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้า

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

ศึกษาอุณหภูมิแคลไชน์ และอุณหภูมิชิ้นเตอร์ ที่เหมาะสมในการเตรียมผงผลึก และเซรามิกบิสมัทโดยเดิมโพแทสเซียมไททาเนตที่เจือ แลนทาล์มอกไซด์ปริมาณ 0.1 wt % (BNKLLT) ด้วยเทคนิคการเผาใหม่ ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิการเผาแคลไชน์ และเผาชิ้นเตอร์ที่ต่างกัน ขนาดของผงผลึก BNKLLT ด้วยวิธีของ Scherrer หาค่าความหนาแน่น ร้อยละความحدัด ขนาดเกรนเฉลี่ย รวมทั้งศึกษาโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค จากเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขั้นดีส่องราก (SEM) รวมทั้งศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLLT

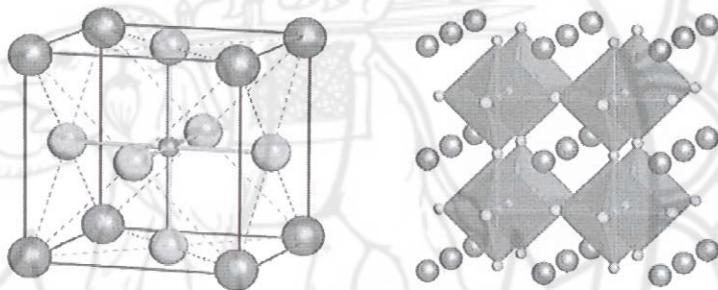
1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

- ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสืออ้างอิง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล
- เตรียมผงผลึกบิสมัทโดยเดิมโพแทสเซียมไททาเนต ที่มีการเจือ แลนทาล์มอกไซด์ในปริมาณ 0.1 wt % (BNKLLT) ด้วยวิธีการเผาใหม่
- วิเคราะห์โครงสร้างเฟสและขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึกที่เตรียมได้
- เตรียมเซรามิก BNKLLT และวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค หาค่าความหนาแน่น ร้อยละการลดตัวขนาดเกรนเฉลี่ยจากเซรามิก และสมบัติทางไฟฟ้า
- สรุปผลการทำโครงงาน จัดทำรูปเล่ม และเตรียมการนำเสนอ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างเพอร์อฟไกต์(perovskite structure)

โครงสร้างเพอร์อฟไกต์มีสูตรทางเคมี คือ ABO_3 ประกอบด้วยอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดใหญ่กว่าตัวอยู่ที่ตำแหน่ง A (A-site) ซึ่งอยู่ที่มุมทุกมุมของหน่วยเซลล์ (unit cell) และมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าต่ำกว่า อาทิ เช่น K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} และ Pb^{2+} ส่วนที่ตำแหน่ง B (B-site) ซึ่งอยู่ตรงกลางของหน่วยเซลล์จะมีอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดเล็กและมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าสูงกว่าตัวอยู่ อาทิ เช่น Ta^{5+} , Ti^{4+} , Zr^{4+} และ Sn^{4+} โดยไอออนบวกนี้จะถูกกล้อมรอบด้วยไอออนลบของออกซิเจน 6 ตัวจับตัวกันเป็นรูปหกเหลี่ยม (octahedral) ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างแบบเพอร์อฟไกต์ (ABO_3)

2.2 โพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric)

คำว่า “โพอิโซ (piezo)” มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “กด” ดังนั้นสมบัติโพอิโซอิเล็กทริก คือ การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกด ซึ่งเป็นแรงทางกลประภูมิโพอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric) ได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ชองส์ และปีแอร์ คูรี (Jacques and Pierre Curie) ในปี ค.ศ.1880 ขณะที่ศึกษาผลของความดันต่อประจุไฟฟ้าของผลึกบางประเภท เช่น ควอร์ซ (quartz) ชิงค์ เบลน (zincblende) หัวมาลีน (tourmaline) การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกดซึ่งเป็นแรงทางกลทำให้เกิดความเครียด (strain) ในผลอก มีผลทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของไดโอลโนมเมนต์ (dipole moment) ไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่า การโพลาไรเซชัน (polarization) และให้กระแสไฟฟ้าออกมายโดยปริมาณและเครื่องหมายของการโพลาไรเซชันจะแปรผันตามความเครียดที่ได้รับ และในทางกลับกัน เมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่สารจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือความเครียด ขึ้นในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป

ความเข้าใจในโครงสร้างภายในของวัสดุนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสมบัติ “โพอิโซอิเล็กทริก” ของแข็ง เมื่อทำการพิจารณาวัสดุที่มีผลึกเดียวพบว่า ผลึกมีองค์ประกอบทางเคมีคงที่ และประกอบด้วยไอออน (อะตอมที่มีประจุ) เรียงตัวกันช้าๆ ต่อกันเป็นเครือข่าย ก็จะเป็นระบบผลึก (lattice) หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความสมมาตร เรียกว่า หน่วยเซลล์ (unit cell) และเป็นตัวบอกความเป็นไป

ได้จากการมีสมบัติโพอิโซเล็กทริกในผลึก เนื่องจากความสามารถของโครงสร้างผลึกภายในถูกสะท้อนด้วยความสามารถของสมบัติที่วัสดุนี้แสดงออก

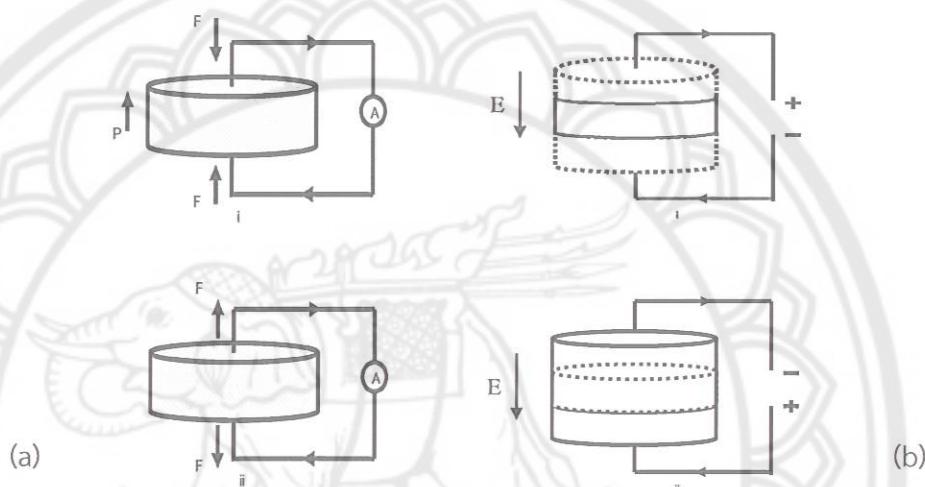


รูปที่ 2 การแบ่งกลุ่มของผลึกของวัสดุใน 32 กลุ่ม

นักผลึกศาสตร์แบ่งผลึกออกเป็น 32 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 2 จากผลึก 32 กลุ่ม ดังกล่าวมี 21 กลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง (noncentrosymmetric) ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โพอิโซเล็กทริกซึ่งพบถึง 20 กลุ่ม อีกหนึ่งกลุ่มที่เหลือไม่มีสภาพเป็นโพอิโซเล็กทริกแม้จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง เพราะเกิดปรากฏการณ์พิเศษบางอย่าง การไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางเป็นสภาวะสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพโพอิโซเล็กทริกเนื่องจากแรงกดที่ให้กับวัสดุเป็นแบบที่มีสมมาตรของศูนย์กลาง และไม่สามารถทำให้เกิดการโพลาไรเซชัน เช่น การเกิดโพลาไรเซชันแบบเวกเตอร์ (vector-quality-likePolarization) นอกจากว่าวัสดุนี้จะมีลักษณะไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางอยู่ ซึ่งจะทำให้รวมของการเคลื่อนที่ของประจุบวกและลบสามารถสร้างได้โพลไฟฟ้าขึ้นมา หรือที่เรียกว่าเกิดโพลาไรเซชันนั่นเอง ความแตกต่างของวัสดุที่เป็นโพอิโซเล็กทริกกับเฟอร์โรอิเล็กทริก คือ วัสดุโพอิโซเล็กทริกไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตัวมันเอง แต่จะเกิดเมื่อให้แรงทางกลต่อผลึกเท่านั้น

สภาพโพอิโซเล็กทริกเกิดขึ้นได้สองแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นตรง (direct effect) และแบบผันกลับได้ (converse effect) ซึ่งแบบแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันเมื่อสารถูกแรงกลกระทำ (หรือเกิดความเค้น) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์โพอิโซเล็กทริกแบบ direct effect เช่น เครื่องกำเนินสัญญาณ

(generator) ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาตร (หรือเกิดความเครียด) ในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ 'โพอิโซอิเล็กทริก' แบบ converse effect เช่น มอเตอร์ (motor) ซึ่งกลไกทั้งสองแบบแสดงในรูปที่ 3 และระดับการเกิดโพลาไรเซชันจะขึ้นกับระดับความเครียดที่เกิดจากแรงที่ได้รับ และเครื่องหมายของประจุที่เกิดขึ้นอยู่กับว่าแรงที่ให้เป็นแรงดึงหรือแรงกด



รูปที่ 3 แสดงปรากฏการณ์โพอิโซอิเล็กทริก (a) แบบ direct effect และ (b) แบบ converse effect

สมบัติตั้งกล่าวว่าจะจะพบได้ในโพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก ซึ่งก็คือ เฟรโรอิเล็กทริกที่ผ่านการสร้างข้าว (poling) นั่นเอง ในระหว่างกระบวนการสร้างข้าวสุดจะเกิดการขยายตัวตามแนวแกนการสร้างข้าวเล็กน้อย และเกิดการหดตัวในทิศทางที่ตั้งฉากกับทั้งสองทิศทางเล็กน้อยเข่นกัน ระดับความแรงของสนามที่สร้างข้าว และอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการจัดทิศทางและสมบัติที่ได้ของสุด การจัดเรียงตัวไม่มีทางเสรีจะสมบูรณ์และโครงสร้างผลึกของวัสดุก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงระดับการสร้างข้าวได้ด้วย เช่น เพสเตรอะโนนอล ทำได้ถึงร้อยละ 83 เฟสرونโนบีซิตรอลทำได้ถึงร้อยละ 86 และสำหรับเฟสออร์ไฮรอนบิค มากถึงร้อยละ 91 ซึ่งเป็นค่าที่สูง เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากผลึกเดียวหรือโดยเมนเดลีว กล่าวได้ว่าเซรามิกทุกชนิดที่ผ่านการเผาผนึก (sintering) แล้วจะมีสภาพเมื่อมองโดยรวมมีสมบัติเหมือนกันในทุกทิศทุกทาง (isotropic) และจะต้องผ่านการสร้างข้าวเพื่อทำให้เป็นโพอิโซอิเล็กทริก โดยที่วัสดุเหล่านั้นเป็นพื้นฐานเฟรโรอิเล็กทริก และเป็นโพอิโซอิเล็กทริกด้วย กระบวนการสร้างข้าวเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสภาพโพอิโซอิเล็กทริกในเซรามิกชนิดเฟรโรอิเล็กทริก หากไม่มีการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นโพอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นโพอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวมีประโยชน์มาก many เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกินอุณหภูมิคริว (curie temperature: T_c) เพราะเซรามิกจะเสียสภาพโพลาไรเซชันที่เกิดจาก การสร้างข้าวที่อุณหภูมิสูงกว่า T_c จาก 20 point groups ของผลึก noncentrosymmetric ที่เป็น

"โพอิโซอิเล็กทริกจะมีอยู่ 10 point groups ที่มีข้อ (polar) เกิดโดยพลโนมเมต์ได้ด้วยตนเอง แม้ไม่ได้รับสนามไฟฟ้ากระทำ เรียกว่ากลุ่มสารพากนี้ว่า spontaneous polarization (Spontaneous Polarization) ผลึกมีข้อเหล่านี้เป็นโพอิโซอิเล็กทริกอย่างมาก และในกรณีที่ให้สนามไฟฟ้าแรงพหุที่เข้าไปจะทำให้ทิศทางของเวกเตอร์โพลาร์ไซซ์ชันเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในสาร point groups นี้เรียกว่า เฟอร์โรอิเล็กทริก นั่นคือสารเฟอร์โรอิเล็กทริกทุกชนิดเป็นสารโพอิโซอิเล็กทริก แต่โพอิโซอิเล็กทริกไม่จำเป็นต้องเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก จะแสดงสมบัติของโมเมนต์คู่คุ่ว (dipole moment) ถึงแม้ว่าเราได้นำสนามไฟฟ้าออกแล้วก็ตาม กล่าวว่ามี ไดโดยพลโนมเมต์ถ้ารออยู่ในผลึกในสถานะเพร์โรอิเล็กทริก จุดศูนย์กลางของประจุบวกของผลึกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับประจุลบ เมื่อเราเอาสารไดอิเล็กทริกมาวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดโพลาร์ไซซ์ชัน ขึ้นภายในสารนั้น และเมื่อลดสนามไฟฟ้าที่ให้จนเป็นศูนย์ โพลาร์ไซซ์ชันในสารไดอิเล็กทริก ก็จะกลับเป็นศูนย์ทันที แต่มีสารบางอย่างเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปทำให้เกิดมิโพลาร์ไซซ์ชัน และเมื่อลดสนามไฟฟ้าลงจนเป็นศูนย์ โพลาร์ไซซ์ชันจะไม่เป็นศูนย์ในสารไดอิเล็กแต่มักจะเป็นศูนย์เมื่อ $E = -E_c$ แสดงว่าในสารมีโมเมนต์ข้าวคู่ ถ้ารออยู่แล้วหรือจากกล่าวได้ว่าสารนั้นแสดงสถานะเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกและอาจทำให้สารแสดงสถานะเพร์โรอิเล็กทริกโดยไม่ต้องใช้สนามไฟฟ้าเลย แต่เราใช้การลดอุณหภูมิแทน โดยปกติสถานะเพร์โรอิเล็กทริกจะไม่ปรากฏที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แน่นอนค่าหนึ่งที่เรียกว่า อุณหภูมิวิกฤต (T_c) ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตนั้น ผลึกจะอยู่ในสถานะ พาราอิเล็กทริก (paraelectric)

2.3 เฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric)

สารเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่ไม่มีความสามารถรักษาจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ จึงทำให้สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องได้รับแรงกล ซึ่งสามารถแยกสารเฟอร์โรอิเล็กทริกออกจากวัสดุไดอิเล็กทริก ด้วยการตัดหัวหรือรีมาเนนท์ โพลาร์ไซซ์ชัน (remanent polarization: P_R) เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเป็นศูนย์ [15] โดยปกตินั้นโพลาร์ไซซ์ชัน (P) เป็นผลมาจากการไฟฟ้าซึ่งจัดเรียงข้าวคู่ของatom (atomic dipole) หรือข้าวโมเลกุล (molecular dipole) อย่างเป็นระเบียบ ในสารหลายชนิดโพลาร์ไซซ์ชันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้า \bar{E} มีความเข้มน้อย

$$\bar{P} = \epsilon_0 \chi_e \bar{E} \quad (1)$$

เมื่อ χ_e เป็นค่าคงที่เรียกว่าสภารับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลาง ค่าของ χ_e ขึ้นกับโครงสร้างทางจุลภาค (microscopic structure) ของสารที่พิจารณาและ ϵ_0 เป็นสภาร ยอมของสัญญาการ (permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ประมาณ $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ โปรดสังเกตว่า สนามไฟฟ้า E ในสมการ (1) นี้เป็นสนามไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากส่วนของประจุอิสระและส่วนของโพลาร์ไซซ์ชันที่สนาม \bar{E} ผลิตขึ้นเอง

χ_e "ไม่มีทิศทาง และการขัดไฟฟ้า (electric displacement: D) มาจากการกระจายประจุอิสระ เท่านั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการ (2)

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + P \quad (2)$$

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์เป็น

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \epsilon_0 \chi_e \bar{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \bar{E} \quad (3)$$

ดังนั้นไม่เพียงแต่ P เท่านั้นที่ขึ้นกับ \bar{E} แต่ \bar{D} ก็ขึ้นกับ \bar{E} ด้วยเช่นกัน

$$\bar{D} = \epsilon \bar{E}$$

(4)

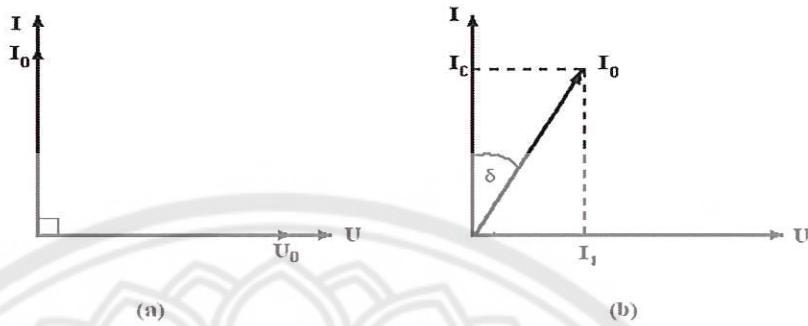
$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (5)$$

เรียก ϵ ว่า สภาพยอม (Permittivity) ของวัสดุในสุญญากาศ ไม่มีสารใดก่อให้เกิดโพลาไรซ์ ดังนั้นสภาพรับไว้ได้ทางไฟฟ้าจึงเป็นศูนย์และสภาพยอม (ϵ) จะมีค่าเท่ากับ ϵ_0 และจากสมการ (5) จะได้

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (6)$$

เมื่อ ϵ_r คือสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือ ค่าคงที่โดยอิเล็กทริกในวัสดุ เพริโอลีเล็กทริก ส่วนใหญ่ค่าคงที่โดยอิเล็กทริก ϵ จะมีค่าสูง ดังนั้น $\bar{P} \gg \epsilon_0 \bar{E}$ และ $D \approx P$ เมื่อป้อนไฟฟ้า กระแสสลับให้กับวัสดุโดยอิเล็กทริก สนามไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าภายในวัสดุ โดยอิเล็กทริก ในกรณีอุดมคติ ไฟฟ้าภายในวัสดุโดยอิเล็กทริกสามารถสัมภาระได้ตามความถี่ของ แหล่งกำเนิด กรณีกระแสสลับ (I) และศักยไฟฟ้า (V) มีความต่างเฟสกันอยู่ 90 องศา ดังรูปที่ 4(a) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ I และ V เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานของวัสดุ โดยอิเล็กทริก (dielectric loss: $\tan \delta$) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการสัมภาระของไฟฟ้าจะก่อให้เกิด ความต้านทานภายในเนื้อวัสดุเอง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น ซึ่งกรณีกระแสไฟฟ้ากับศักยไฟฟ้ามี ความต่างเฟสกันน้อยกว่า 90 องศา ดังรูปที่ 4 (b) โดยการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นนั้น สามารถวัดได้จากการทดลองและเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสภาพยอม

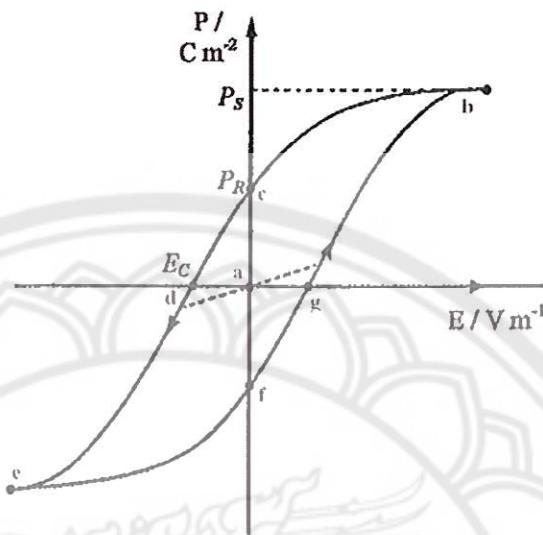
$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \quad (7)$$



รูปที่ 4 ความต่างเฟสระหว่างกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (U) ของวัสดุไดอีเล็กทริก
(a) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (b) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน

ในวัสดุเพรโรอีเล็กทริกการสลับทิศทางของไดโอดตามความถี่ของแหล่งกำเนิด ได้ความสัมพันธ์ระหว่างการโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้า (Polarization versus field) ซึ่งความสัมพันธ์จะพบในรูปของวงรอบไฮสเตอรีซิส (hysteresis loop) ดังรูปที่ 5

เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปครั้งแรกการเกิดโพลาไรเซชันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (saturation polarization) คือจุด b ซึ่งการเกิดโพลาไรเซชันมีค่ามากที่สุด ไดโอดทั้งหมดจะเรียงตัวขนานกัน และหากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านี้ ก็ไม่มีผลต่อการเกิดโพลาไรเซชัน เมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าลดลงแทนที่การโพลาไรเซชันจะถอยกลับไปตามเส้นทางเดิมเหมือนตอนเริ่มต้น ($P = 0$) แต่กลับไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน แม้ว่าไม่มีการให้สนามไฟฟ้า ($E = 0$) แก้วัสดุเพรโรอีเล็กทริกก็ตาม แต่ยังคงมีโพลาไรซ์หลงเหลืออยู่ หรือรีเมานท์ โพลาไรเซชัน (remanent value: P_R) ที่จุด C ถ้าเราต้องการกำจัดโพลาไรเซชันที่ยังหลงเหลืออยู่ เราต้องให้สนามไฟฟ้าย้อนกลับทิศทางเดิม (นั่นคือ $-E$) โพลาไรเซชันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด d ซึ่งเรียกว่าสนามโคเออร์ซีฟ (coercive field: E_C) ถ้าเราพยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบนี้สูงขึ้นอีก ในที่สุดก็จะถึงจุดอิ่มตัว ที่จุด C ข้ามไปโลหะทั้งหมดซึ่งเป็นทางขวา เมื่อถึงจุดอนนี้ ถ้าไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับวัสดุเพรโรอีเล็กทริก แล้วปล่อยให้วัสดุที่มีโพลาไรเซชันเพิ่มขึ้นไปทางขวา ยังจุด f เพื่อให้ครบวงจร ต้องป้อนกระแสไฟฟ้าอีกรั้งในทิศทางบวก โพลาไรเซชันจะกลับสู่ศูนย์ที่จุด g และในที่สุดก็จะมุ่งไปสู่จุดอิ่มตัวที่จุด b [15, 16]

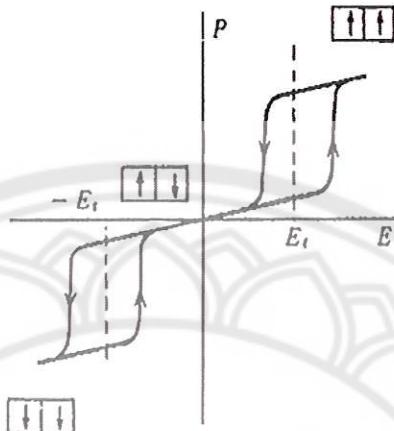


รูปที่ 5 วงรอบยิสเทอเรชิสระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟอร์โรอิเล็กทริก

2.4 แอนติเฟอร์โรอิเล็กทริก (Anti ferroelectric)

สารแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับแรงกลเข่นเดียวกับสารเฟอร์โรอิเล็กทริก แต่ทิศทางของโพลาไรเซชันในแต่ละโดเมน (โดเมน คือ บริเวณที่ห่วงเชลล์มีสภาพขั้วเหมือนกัน) จะมีทิศทางตรงกันข้ามกันเกิดการหักล้างกัน ทำให้ค่าโพลาไรเซชันสุทธิ (net polarizations) มีค่าเป็นศูนย์ สารแอนติเฟอร์โรบางชนิดเมื่อถูกเหนี่ยวนำโดยสนามไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นสารเฟอร์โรอิเล็กทริกได้ [17]

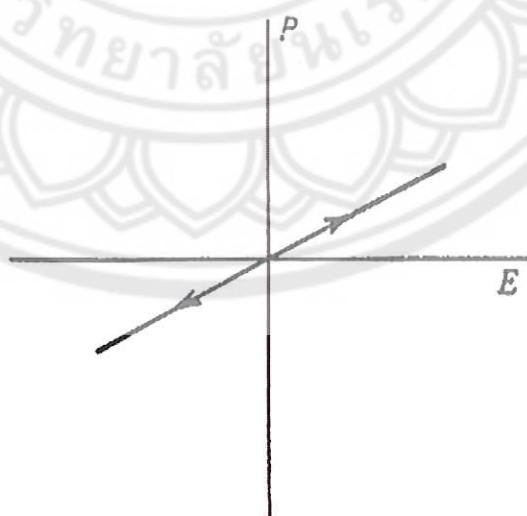
ในสนามไฟฟ้าต่ำ สารแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าโพลาไรเซชันที่ถูกเหนี่ยวนำ (induced polarizations) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเกินกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต (critical field, E_{crit}) ทำให้ผลึกภายในเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกและโพลาไรเซชันจะแสดงยิสเทอเรชิส ที่มีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้า หากหยุดป้อนสนามไฟฟ้าดังกล่าวผลึกจะกลับเป็นสถานะแอนติโพลาร์ (anti polar state) และโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้น โดยธรรมชาติของสารแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีวงรอบยิสเทอเรชิส 2 วง (double hysteresis curve) ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 วงรอบอิสเทอร์ซิสระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในของสารแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก [17]

2.5 พาราอิเล็กทริก (Paraelectric)

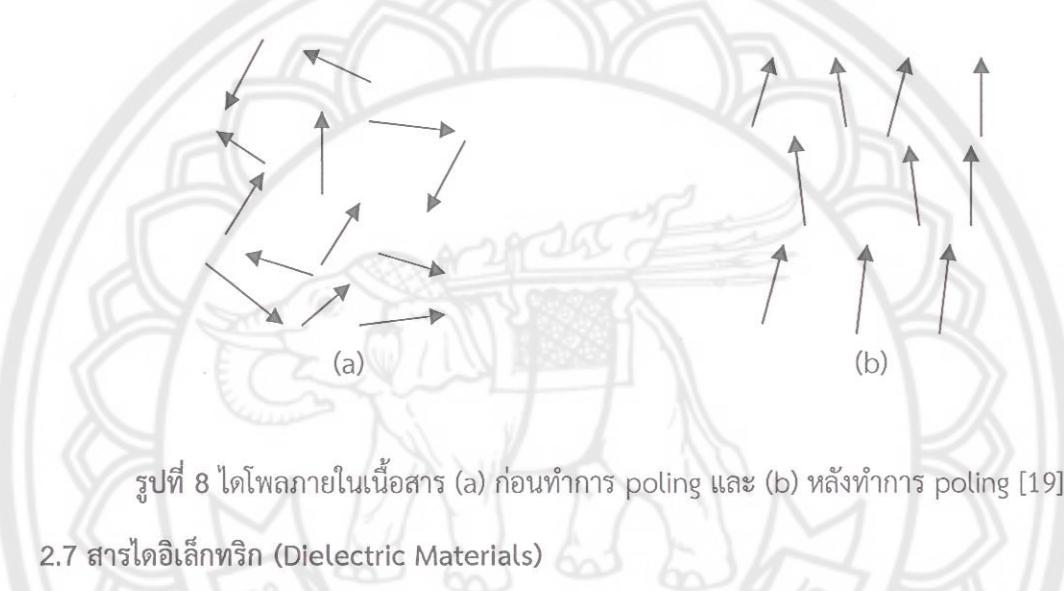
เฟสพาราอิเล็กทริกเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเฟสเฟร์โรอิเล็กทริกและเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก [18] ซึ่งสารพาราอิเล็กทริกจะประพฤติตัวเป็นฉบวนตามปกติ มีโครงสร้างที่สมมาตร จึงไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการป้อนสนามไฟฟ้าให้กับสารพาราอิเล็กทริก ทำให้เกิดโพลาไรเซชันขึ้น แต่เมื่อยุดป้อนสนามไฟฟ้าเข้าไป ผลกระทบคือไม่มีการเกิดโพลาไรเซชันขึ้นอีก ซึ่งเปียนความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 วงรอบอิสเทอร์ซิสระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในของสารพาราอิเล็กทริก

2.6 โพลาไรเซชัน (Polarization)

เมื่อเราพิจารณาสารเซรามิก ที่ประกอบด้วยผลึกก้อนเล็กๆ ที่มีทิศทางของไดโอล่าต่างกัน การที่ไดโอลไม่เรียงตัวเป็นระเบียบนี้ ทำให้เซรามิกไม่สามารถวัดค่าไฟอิโซอิเล็กทริกได้แต่เมื่อมีการให้สนามไฟฟ้าเข้าไปในสารตัวอย่าง หรือการสร้างขึ้นให้แก่สาร (poling) นี้จะทำให้เกิดโพลาไรเซชัน หรือไดโอลภายในเนื้อสารอยู่ในทิศทางใกล้เคียงกัน หรือทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เข้าไป ดังรูปที่ 8 เพื่อเพิ่มสมบัติการเป็นไฟอิโซอิเล็กทริก และสมบัติทางไฟฟ้าด้วย [19]



รูปที่ 8 ไดโอลภายในเนื้อสาร (a) ก่อนทำการ poling และ (b) หลังทำการ poling [19]

2.7 สารไดอิเล็กทริก (Dielectric Materials)

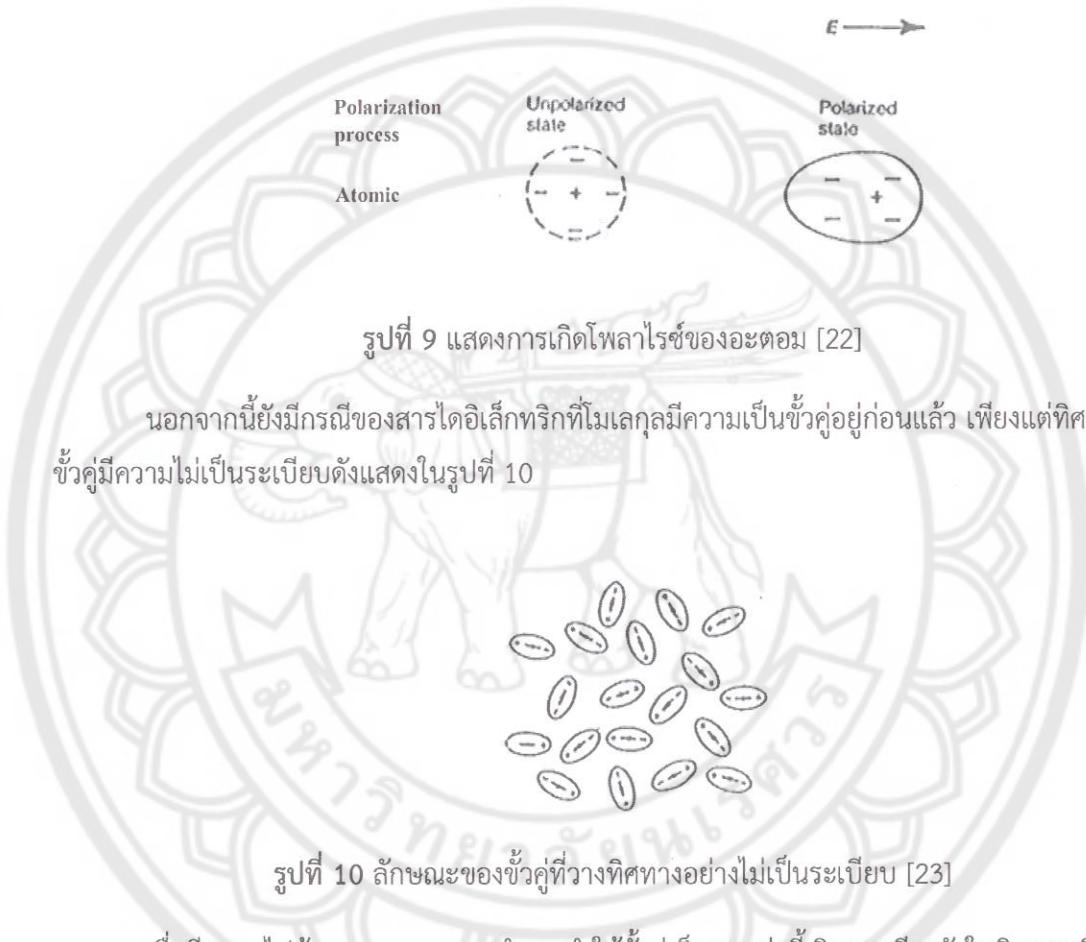
จากการค้นพบสารไดอิเล็กทริกเป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1921 [20] แบบเรียมไททาเนต (BaTiO_3) เป็นวัสดุตัวแรกที่ถูกค้นพบซึ่งนิยมนำมาใช้ในการทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า (capacitor) เนื่องจากมีค่าส่วนพยอมสัมพัทธ์สูง (high relative permittivity) นอกจากแบบเรียมไททาเนตแล้วยังพบว่า เลดไททาเนต (PbTiO_3) เลดเซอร์โคเนตไททาเนต (PZT) เลดแอลนทานัมเซอร์โคไททาเนต (PLZT) และลดแมกนีเซียมไนโอลเบต (PMN) ก็เป็นสารประกอบที่มีค่าส่วนพยอมสัมพัทธ์สูง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการเติมสารเจือต่างๆ เพื่อปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กทริกให้ดีขึ้นและการเพิ่มค่าอุณหภูมิคิรี (curie temperature หรือ T_c) เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอุณหภูมิที่จะใช้งาน [21]

2.8 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric properties)

สมบัติไดอิเล็กทริก คือ สมบัติของการเป็นอนุภาคไฟฟ้า ในวัสดุที่เมื่อยูนิฟายในสภาพปกติจะประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีจุดศูนย์กลางมวลร่วมกับระหว่างโปรตอน และกลุ่มอิเล็กตรอน ที่อยู่ภายใต้แรงยึดของโมเลกุล และแรงยึดของอะตอม ภายในเนื้อสารจะไม่มีประจุไฟฟ้าอิสระ แต่เมื่อมีสนามไฟฟ้าผ่านเข้าไปใน

สารตั้งกล่าวจะทำให้โมเลกุลเกิดแรงทางไฟฟ้า เนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทำกับโมเลกุลจะทำให้กลุ่มประจุบวกและกลุ่มประจุลบเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้โมเลกุลของสารเกิดเป็นโมเมนต์ขั้วคู่ (dipole moment) ขึ้นมา ดังแสดงในรูปที่ 9

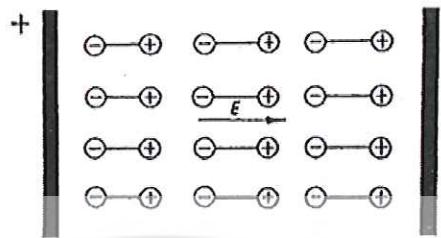


รูปที่ 9 แสดงการเกิดโพลาไรซ์ของอะตอม [22]

นอกจากนี้ยังมีกรณีของสารไดอิเล็กทริกที่โมเลกุลมีความเป็นขั้วคู่อยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ทิศทางของขั้วคู่มีความไม่เป็นระเบียบดังแสดงในรูปที่ 10

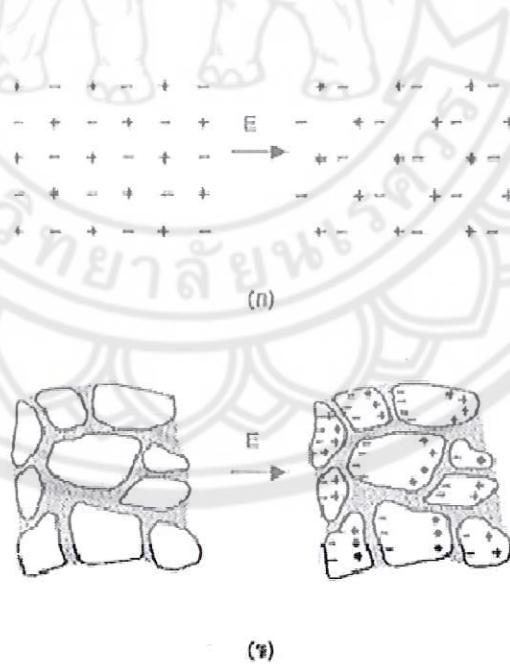
รูปที่ 10 ลักษณะของขั้วคู่ที่ว่างทิศทางอย่างไม่เป็นระเบียบ [23]

เมื่อมีสนามไฟฟ้าภายนอกมากระทำ จะทำให้ขั้วคู่เล็กๆ เหล่านี้เกิดการเรียงตัวในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ เมื่อพิจารณามวลสารทั้งหมดของสารไดอิเล็กทริก จะเห็นว่าประจุบวกทั้งหมดม้ายห่างออกจากประจุลบ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า สารไดอิเล็กทริกนั้นถูกโพลาไรซ์ (polarized) ดังแสดงในรูปที่



รูปที่ 11 แสดงการเกิดโพลาไรซ์ของสารไดอุเล็กทริก [24]

นอกจากกระบวนการ atomic และ dipole polarizations ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมีกระบวนการ ionic และ space charge polarizations ที่สามารถทำให้เกิดโน้มนต์ขั้วคู่ได้เช่นกัน โดยกระบวนการ ionic polarization จะเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีพันธะไอออนิกที่เกิดการเลื่อนตำแหน่งของไอออน บวกและไอออนลบไปจากสมดุลของผลัดทิชพารามิเตอร์ในโครงสร้างผลึก เนื่องจากมีสนามไฟฟ้าภายนอกเข้ามาเหนี่ยวนำทำให้มีขั้วคู่ สำหรับกรณีกระบวนการ space charge polarization นั้น จะเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีขอบเขต เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอกมาเหนี่ยวนำทำให้ประจุที่อยู่ในスペースสมดุล เกิดการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมไปอยู่ที่บริเวณขอบเขต ทำให้เกิดขั้วคู่ขึ้น [25] แสดงดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 แสดงกระบวนการเกิดโพลาไรเซชันแบบ (η) ionic (χ) space charge [22]

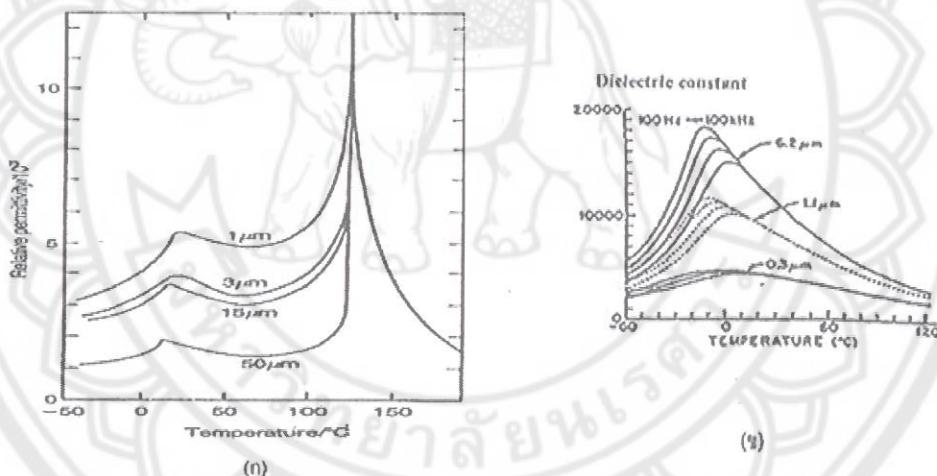
2.9 ผลของโครงสร้างจุลภาคที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก

ภายในเนื้อของวัสดุพวกเซรามิกออกไซเดอร์ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ผลึกที่มีโครงสร้างที่แน่นอน โดยมีอัตราการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบตลอดทั่วทั้งเนื้อของวัสดุ ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังจากที่ได้มีการให้ความร้อนที่เหมาะสมแก่วัสดุแล้วปล่อยให้เย็นตัวลง โดยที่ผลึกที่อยู่ภายในเนื้อสารได้รับความร้อนก็จะเกิดการเติบโต ทำให้มีรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกิดการเคลื่อนที่ขันกันของขอบผลึกอื่นๆ จนเกิดเป็นโครงสร้างทางจุลภาคที่มีลักษณะเฉพาะและประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่าเกรน (grain) เรียงตัวเกะติดกันตลอดทั่วทั้งวัสดุ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์เข้ามาช่วย และเรียกบริเวณขอบหรือรอบตัวที่เกิดจากการเคลื่อนที่เข้ามาชนนี้ว่าขอบเกรน (grain boundaries) ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีการจัดเรียงอะตอมอย่างไม่เป็นระเบียบสูง เมื่อเทียบกับการจัดเรียงอะตอมภายในเกรน ทำให้อัตราการท่อผ่านของบริเวณขอบเกรนมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูงกว่าและเนื่องจากอะตอมบริเวณนี้จะอยู่แบบค่อนข้างเป็นอิสระจึงทำให้บริเวณนี้มักมีสีงันเป็นสองสี

ขนาดเกรนของเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริก จะมีผลอย่างมากกับค่า E_r ของเซรามิกจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าค่า E_r สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของเกรนและอุณหภูมิเชิงเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริกแบบธรรมชาติ เช่น แบบเรียมไททาเนต ซึ่งมีขนาดเกรนประมาณ $1-50 \mu\text{m}$ มีรายงานผลการวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าเซรามิกที่ประกอบด้วยเกรนที่มีขนาดเล็กจะมีค่า E_r สูงมากกว่าเซรามิกที่ประกอบด้วยเกรนที่มีขนาดใหญ่ แต่ต่อไปนี้จะกล่าวถึงขนาดของเกรนมีค่าต่ำกว่า $1 \mu\text{m}$ ครองแล้วค่า E_r ของเซรามิกเหล่านี้กับมีแนวโน้มที่ลดลงจากรูปที่ 13(g) จะเห็นได้ว่าที่สถาบันพาราอิเล็กทริกนั้นค่า E_r จะเป็นไปตามกฎของ Curie – Weiss จากที่ได้กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าขนาดเกรนของเซรามิกนั้นมีอิทธิพลต่อค่า E_r ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการนำเซรามิกไปใช้งาน ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะควบคุมขนาดของเกรน เพื่อกำหนดลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกให้มีความเหมาะสมต่อการแสดงสมบัติทางไดอิเล็กทริกตามที่ต้องการเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการที่นิยมใช้กันอยู่ 2 วิธีหลัก คือ

1. การควบคุมขนาดของเกรนด้วยการเลือกใช้เงื่อนไขในการเตรียมที่เหมาะสม
2. การเจือสารอื่นเข้าไปในสารหลักเพื่อปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าและโครงสร้างทางจุลภาคของสารให้เหมาะสม

ส่วนกรณีของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบบีแลกเซอร์ เช่น PMN นั้น พบร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเกรนกับค่า ϵ_r จะตรงกันข้ามกับกรณีของแบเรียมไทเทเนต นั่นคือ เมื่อเกรนของเซรามิกมีขนาดเพิ่มขึ้น ค่า ϵ_r จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย [26,27,28] ดังแสดงในรูปที่ 13(ก) นอกจากนี้ยังพบว่าค่า ϵ_r ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ปริมาณเฟสไฟโรคลอร์ (pyrochlore) ที่มักเกิดขึ้นไปพร้อมกับเฟสของ PMN ซึ่งเฟสปนเปื้อนเหล่านี้จะมีค่า ϵ_r ต่ำมาก เนื่องจากไม่ได้เป็นสารพากเฟอร์โรอิเล็กทริก ทำให้เซรามิกมีค่า ϵ_r ลัพธ์ (สุทธิ) ลดลงจากที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ค่าความหนาแน่น (density) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อค่า ϵ_r เป็นอย่างมาก เนื่องจากเซรามิกที่มีค่าความหนาแน่นต่ำจะมีช่องว่างหรือรูพรุนอยู่มาก จึงมีค่า ϵ_r ของอากาศหรือรูพรุนภายในเซรามิกที่ส่งผลกระทบต่อค่า ϵ_r ของเซรามิกดังกล่าวทำให้ค่า ϵ_r สุทธิของเซรามิกที่มีความหนาแน่นต่ำมีค่าลดลง ดังนั้นการเตรียมเซรามิกเพื่อให้ได้สมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานตามที่ต้องการ จึงต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วย



รูปที่ 13 แสดงผลของขนาดเกรนที่มีต่อค่า ϵ_r ของเซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริก (ก) แบบบีแลกเซอร์ เช่น BaTiO_3 [22] และ (ห) แบบบีแลกเซอร์ เช่น PMN [28]

2.10 ค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริก

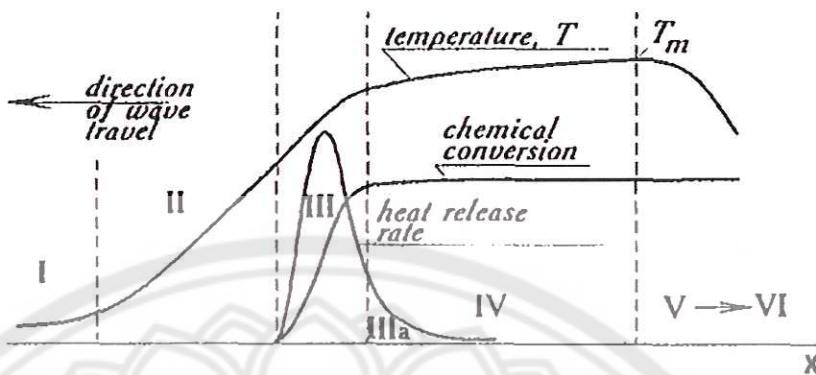
ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับกับสารไดอิเล็กทริกนั้น ข้อคุ้มทางไฟฟ้าหรือไดโอลในเนื้อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปมา ซึ่งการที่จะเปลี่ยนได้ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของสนามไฟฟ้าที่ให้ โดยถ้าความถี่สูงเกินไปจะทำให้ไดโอลไม่สามารถปรับตัวให้ทันตามความถี่ทำให้เกิดการหดตัวของไดโอลเนื่องจากความเสีย เมื่อหดตัวนั่นก็จะทำให้เกิดความร้อนขึ้น (Loss) ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เป็น

ที่มาของค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริก (Dielectric loss; tan δ) การใช้งานของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกแทบจะทุกชนิดมีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าดังนี้ การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งค่าสภาพยอมสัมพัทธ์เป็นสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัสดุไฟอิเล็กทริกซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง (High dielectric constant) อยู่ในช่วง 200-10000 เทียบกับวัสดุที่เป็น conductor มีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง 5-100 เมนະกับการประยุกต์ใช้งานทางด้านตัวเก็บประจุ
2. มีค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริกต่ำ (Low dielectric constant) อยู่ในช่วง 0.1% - 7%
3. มีสภาพความด้านทานทางไฟฟ้าสูง (High specific electric resistivity) มากกว่า $10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$
4. สามารถการเบรกดาวน์ได้พอสมควร (Moderate dielectric breakdown) ประมาณ 100 – 120 kV/cm สำหรับเม็ดเซรามิกและประมาณ 500 – 800 kV/cm สำหรับแผ่นเซรามิกบางๆ

2.11 เทคนิคการเผาไหม้

การเตรียมผงด้วยวิธีการการเผาไหม้ เป็นการใช้ประโยชน์จากการผลิตปล่องพลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนการผลิต มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Beketov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมาได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการผลิตเทาหลอมเหล็ก การผลิตเฟอร์โรอัลลอย ฯลฯ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทฤษฎีการเผาไหม้ (combustion) ยุคใหม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัตินามา (ในปี ค.ศ.1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ.1950-1960 สำหรับของเหลว) ในปี ค.ศ.1967 ได้มีการค้นพบปรากฏการณ์จุดระเบิดของของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตในสถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาไหม้บนพื้นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ถูกนำไปเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการเผาไหม้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการเผาไหม้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สำหรับวัสดุชั้นสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดยการประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎีการเผาไหม้และโครงสร้างจนพลศาสตร์มหันภาศ ของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปของการเผาไหม้ ได้ดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการการเผาไหม้

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สาม เป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามีการเกิดการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่กว้างที่สุดของช่วงนี้ คือ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟสและโครงสร้างของวัสดุ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างช้าๆจะทำให้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการการเผาไหม้ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการปลดปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับเฟส โครงสร้าง เจื่อนไช และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ

2.12 การซินเตอร์

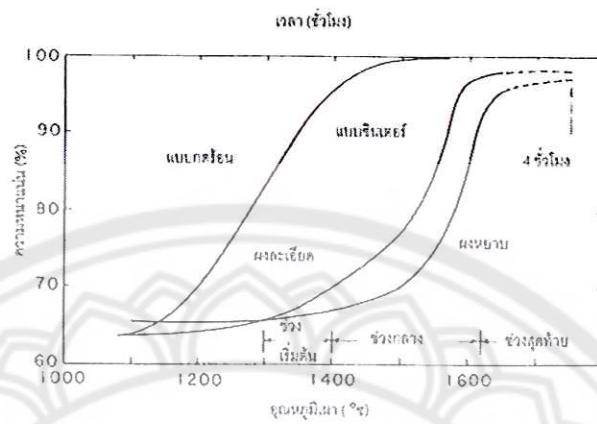
การซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง

การซินเตอร์ (sintering) คือ กระบวนการทางความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิกัดการสร้างพื้นที่กันอย่างสมดุล โดยมีโครงสร้างหลักเป็นของแข็ง ที่พัฒนาจากการเคลื่อนย้ายมวลลักษณะ ต่าง ๆ ที่มีกจะเกิดขึ้นในระดับของอะตอม การเกิดพื้นที่เชื่อมต่อ กันดังกล่าวทำให้ระบบมีความแข็งแรงสูงขึ้นและมีพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจจะกล่าวได้ว่าการซินเตอร์นั้น หมายถึงการกำจัดรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาคผิวเริ่มต้น โดยอาศัยการหดตัวขององค์ประกอบที่เชื่อมอยู่ติดกันแล้วเกิดการเติบโตไปด้วยกัน โดยมีการสร้างพื้นที่ที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกันขึ้นมาทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสภาพ ขั้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกันของกรนต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซินเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการซินเตอร์นั้นได้มาจากการลดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิวด้วยการใช้ของแข็งที่เชื่อมยึดกันโดยมีพลังงานของกรนแบบของแข็ง-ของแข็ง (ggb) ที่

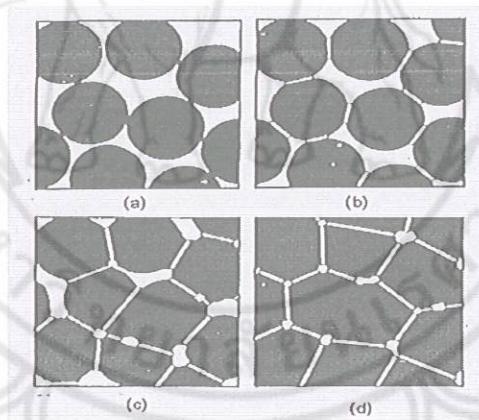
ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่ก่อมอนูภาคผงที่ยึดกันอยู่อย่างหลวม ๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ (γsv) ที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ของการผลิตเซรามิกส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกใช้ออนูภาคผงตั้งต้นที่มีขนาดอนูภาคเล็ก เนื่องจากอนูภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็จะยิ่งมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ขั้นงานสามารถเกิดการแน่นตัวได้ จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้ [29]

การทดสอบของขั้นงานเซรามิกขณะที่ทำการซินเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาดหรือหาค่าความหนาแน่นของขั้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเวลาในการเผา ดังเช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ทั่ว ๆ ไป ที่แสดงดังรูปที่ 15 ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลักที่มีความคิดเห็นว่าต่อเนื่องกันอยู่คือ

1. การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งของอนูภาคผงภายในขั้นงานและการเกิดพื้นธารที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุดสัมผัสระหว่างอนูภาคผง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของขั้นงานในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนูภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รูปที่ 16 (b) การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและปริมาณของความพรุนในขั้นงานจะรีบลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนูภาคเริ่มเข้ามาใกล้ชิดติดกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ขั้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มมีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่ช่องว่างของรูพรุนจะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อกัน (พวกรูพรุนเปิด) และจะสิ้นสุด พฤติกรรมนี้ในทันทีเมื่อรูพรุนเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพรุนปิด) การหดตัวของขั้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของขั้นงานมีค่าสูง(รูปที่ 16 (c))
2. การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย(final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพรุนในขั้นงานเริ่มปิดตัวเองลงและค่อย ๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากขั้นงานอย่างช้า ๆ โดยอาศัยกลไกการแพร์ของอากาศจากรูพรุนออกตามแนวของขอบเกรน แล้วหลุดออกไปจากผิวของขั้นงาน ซึ่งจะทำให้ขั้นงานเกิดการแน่นตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ รูปที่ 16 (d)



รูปที่ 15 พฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งทั่วๆ ไปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา



รูปที่ 16 พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง

(a) อนุภาคผงยึดกันอยู่แบบหลวມๆ หลังการอัดขี้นรูป

(b) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น

(c) การซินเตอร์ช่วงกลาง และ

(d) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว(liquid phase sintering) เป็นกระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุเกิดการหลอมเหลวขึ้นจนถาวรสภาพไปเป็นของเหลวในระหว่างที่มีการซินเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตเซรามิก ด้วยการใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์ที่ต่ำลง เนื่องจากโดยปกติแล้ววัสดุพลาสติกส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากบางชนิดอาจสูงถึงประมาณ 1300 องศาเซลเซียส ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานที่สูงมากในการเผาซินเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีเวลาไฟอยู่ไม่นาน ประเภทที่สามารถใช้งานภายใต้เงื่อนไขนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารในภาชนะที่หลอมตัว กับภาชนะเองได้่ายอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเซรามิกเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำลงด้วยการใช้สารช่วยหลอมหรือฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งเป็นอนุภาคผงที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ขึ้นงานเกิดการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าสารองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มาก จึงเกิดเป็นเฟสที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายที่ในระหว่างการซินเตอร์ได้รวดเร็วขึ้นกระบวนการซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลวมีอยู่สองระบบคือ

- ระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อขึ้นงานได้รับความร้อนจนกระแทกถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นและคงสภาพอยู่ตลอดช่วงของการซินเตอร์และเมื่อขึ้นงานเริ่ม เย็นตัวลงเฟสที่เป็นของเหลวนี้จะเกิดการแข็ง ตัวแยกเฟสอยู่ในขึ้นงาน
- ระบบที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อขึ้นงานได้รับความร้อนจนกระแทกถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นแล้วค่อย ๆ หายไปช้า ๆ ด้วยการละลายลงไปอยู่ในเมทริกซ์ของขึ้นงาน

กระบวนการซินเตอร์ที่มีเฟสของเหลวประกอบด้วย 4 ระยะหลักดังนี้

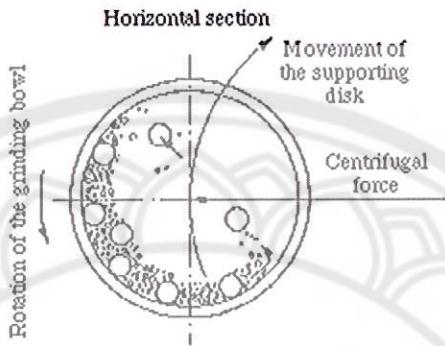
- ระยะท่อน้ำนมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ (particle rearrangement stage) หลังจากที่มีการหลอมเหลวเกิดขึ้นอนุภาคของแข็งจะถูกแรงดันรูเล็กจากของเหลวดึงเข้าหากัน ทำให้ขึ้นงานเกิดมีการหดตัวอย่างรวดเร็ว และมีการกำจัดรูพรุนออกไปจากขึ้นงาน
- ระยะท่อน้ำนมีการแยกออกจากกันแล้วเกิดการตกตะกอนช้า (dissolution reprecipitation stage) มีหลักการณ์ท่อน้ำนมของแข็งสามารถแยกออกจากกันของอนุภาคของแข็งและความดัน ณ จุดสมดุลระหว่างอนุภาคของแข็งจะช่วยทำให้เกิดมีการแยกออกจากกันของอนุภาคได้ เมื่อเกิดมีการละลายขึ้น ตัวถูกละลายจะแพร่เข้าสู่จุดที่มีความโดยตรงกับขั้นตอนภายในโครงสร้างจุลภาค และเกิดการตกตะกอนจนทำให้เกรนบริเวณดังกล่าวมีขนาดโตขึ้นซึ่งตัวที่ตกตะกอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับอนุภาคของแข็งเริ่มต้นก็ได้แต่อาจจะเป็นตัวใหม่ที่มีองค์ประกอบของห้องที่ได้จาก

เฟสที่เป็นของแข็งและที่เป็นของเหลวอยู่ร่วมกัน ซึ่งการตกตะกอนในลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้ปริมาณเฟสของเหลวที่เกิดขึ้นในระบบลดลงขณะที่มีการตกตะกอน

3. ระยะที่ของเหลวมีการสมานลักษณ์ (liquid assimilation) ในบางกรณีของเหลวจะเข้าไปปะปนอยู่ร่วมกับเฟสที่เป็นของแข็งได้โดยตรงด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรืออาจจะเข้าไปแทรกอยู่ด้วยแรงกล จนทำให้เกิดการเป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลายของแข็งที่เกิดจาก การคัดซับของเหลวหรือเกิดไฟสใหม่ที่ตอกผลึกมาจากการที่เกิดการหลอม
4. ระยะที่มีการเติบโตของเกรนในสถานะของแข็ง (solid state grain growth stage) เมื่อของเหลวถูกรีดออกมากจากอนุภาคที่อัดกันแน่น หรือมีการเพรซึมเข้าไปอยู่ภายในของแข็ง จะทำให้เกิดมีขอบเกรนปรากฏขึ้นมา ซึ่งถ้าหากระบบยังมีการซินเทอร์อยู่ก็จะมีพฤติกรรมการเติบโตของเกรนเป็นขั้นตอนหลักที่ custody ควบคุมพุติกรรมของการซินเทอร์ต่อไป

2.13 การบดย่อยด้วยลูกบด (Ball milling)

เป็นกระบวนการบดย่อยอนุภาคของวัตถุดิบที่อาศัยการหมุนหม้อบด ซึ่งเป็นแท่งกลวง ทรงกระบอกที่มีฝาปิด-เปิดได้อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง ในแนวนอน หม้อบดส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งานกันในระดับห้องปฏิบัติการ มักจะทำด้วยกระปองพลาสติกแบบง่าย ๆ ที่สามารถกำจัดเศษพลาสติกที่ปนเปื้อนมากับการบดย่อยได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิต่ำ หรือในบางกรณีก็จะใช้หม้อบดเซรามิกที่ทำด้วยพอร์ซเลน ก่อนที่จะทำการหมุนหม้อบดจะต้องมีการใส่วัตถุดิบที่ต้องการจะลดขนาด หรือที่เรียกว่า ประจุ (charge) พร้อมกับลูกบด (ball) หรือลูกบด (grinding media) และสารเติมแต่งอื่น ๆ เช่น สารเจือ หรือสารช่วยหล่อลื่น เป็นต้น ลงไว้ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของหม้อบดโดยจะต้องพยายามปรับอัตราส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้ในหม้อบด ให้ระบบหั้งชุดสามารถเกิดพุติกรรมการบดย่อย กล่าวคือ ลูกบดจะต้องมีการเคลื่อนที่คล้าย ๆ กับตัวอักษร D โดยมีการเคลื่อนที่ไล่เลียงกันแล้วตกลงมากระแทกกับวัสดุด้านล่าง (รูปที่ 17) จากนั้นก็มีการหมุนเบียดเสียดกัน และมีการเลื่อนไหหลีเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไป ทำให้อนุภาคของวัตถุดิบมีขนาดลดลง เนื่องจากลูกกระแทกด้วยลูกบด ถูกขัดศีรษะหัวงลูกบด และระหว่างลูกบดกับผนังของหม้อบด ในขณะที่พุติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยทำให้ขนาดของอนุภาคลดลง การเกิดสิ่งเจือปนก็อาจจะมีขึ้นในขั้นตอนเหล่านี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นขั้นส่วนของลูกบด หรือผนังของหม้อบดที่สึกกร่อนหลุดไปเข้ามาด้วย [30,31]



รูปที่ 17 ภาพตัดขวางแสดงองค์ประกอบหลักของการบดย่อยด้วยลูกบอล (ball-milling) และแสดงลักษณะพัฒนาระบบการบดย่อยแบบเลื่อนหล่นกันไป (cascading)

2.14 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer)

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก รังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการทะลุทะลวงสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 อั้งstrom การเกิดอันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้ [32]

1. ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ใช้ศึกษาหาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

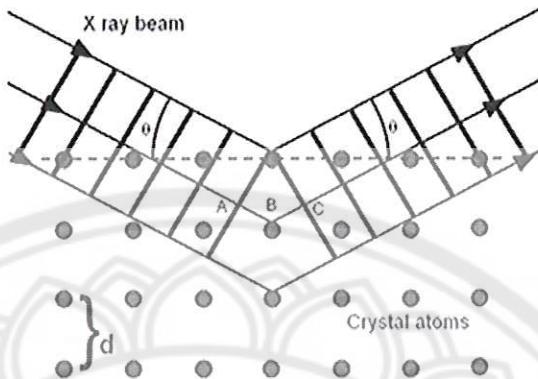
รังสีเอกซ์มีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการสลายตัวของนิวเคลียสราดิกัมมันตั้งแต่รังสีและที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากการไกทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออะตอมได้รับการกระแทกตุนด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง วิ่งชนอะตอม ทำให้เกิดอันตรกิริยา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนั้นจะໂຄຈรต่าง ๆ ของอะตอมมีค่าสูงขึ้น เกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมวลของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ่อนอกมาในลักษณะพลัส (Pulse) จากอะตอมทุกครั้งที่ได้รับการกระแทก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสีเอกซ์” ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณชั้นโคจรอิเล็กตรอน คือ

(1) รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดี่ยว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ อิเล็กตรอนหรืออนุภาคที่มีประจุชนิดอื่น ๆ หรือโฟตอนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวงโคจร ขึ้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนขึ้นในวงโคจรได้รับพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่า พลังงานยึดเหนี่ยวของขั้นวงโคจร ทำให้หลุดจากวงโคจรเกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในขั้นวงโคจรขึ้น ทำให้ อะตอมอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นและจะลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดย อิเล็กตรอนของวงโคจรในขั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงโคจรขึ้นใน ด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานิรูปรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามาแทนที่ของว่างของวงโคจรขึ้นใน พลังงานส่วนเกินนี้จะมีค่าเท่ากับความต่างระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะวงโคจรของอิเล็กตรอน และชนิด ของธาตุนั้น ๆ จึงมีพลังงานเฉพาะค่า

(2) รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุด ถึงสูงสุด ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคูลอมบ์ (Coulomb field) บริเวณใกล้นิวเคลียส ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตย์บริเวณดังกล่าวทำให้ อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานะ

ก่อนที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิจะทำลัมตรริยิกับสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้นิวเคลียสที่เกิดจากประจุ ของอะตอม อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานบางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิงของอิเล็กตรอน ดังนั้นพลังงาน ของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้น จึงมีค่ากระจาดต่อเนื่องจากพลังงานต่ำสุดถึงสูงสุดของอิเล็กตรอนปฐมภูมิ ถ้า อิเล็กตรอนปฐมภูมิมีพลังงานสูงพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในวงโคจรขึ้นในของอะตอมหลุดออกจากได้ ก็จะ เกิดรังสีเอกซ์เฉพาะค่าปะปนอยู่กับสเปกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องด้วยเสมอ การปลดปล่อยรังสีเอกซ์ ออกมานี้ความยาวคลื่นได้ ๆ ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่คายออกมานะ จึงความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดเกิดจากการ ที่อิเล็กตรอนคายพลังงานที่ได้รับมาหักหมัดจากแหล่งกำเนิดโดยไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าหมายที่ใช้

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวน้ำของผลึกโดยทำมุม θ บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการกระเจิง ด้วยขั้นของอะตอมที่ผิวน้ำ อีกส่วนหนึ่งของลำรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังขั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนจะ กระเจิงและส่วนที่เหลือจะผ่านเข้าไปยังขั้นที่ 3 ของอะตอมดังรูปที่ 18



รูปที่ 18 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกค์

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กัน จำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลำ鞭านกัน สิ่งสำคัญในการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับภาระ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตกกระทบ รังสีเลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวน้ำจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมควรมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

เมื่อปี ค.ศ. 1912 แบรกค์ได้ยิงลำรังสีเอกซ์แคบ ๆ กระทบผิวน้ำผลึกเป็นมุน θ เพื่อให้เกิดการเลี้ยวเบนและการกระเจิงเมื่อเกิดอันตรกิริยากับอะตอม O , P และ R ถ้า

$$SQ + QT = n\lambda \quad (8)$$

เมื่อ n คือ จำนวนเต็ม รังสีที่กระเจิงจะอยู่ในไฟฟ้าที่ OCD ผลึกจะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์ จะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin \theta \quad (9)$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เขียนสนการใหม่ได้ว่า

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (10)$$

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกค์ (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับการศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดียว (single crystal) และผลึกเชิงซ้อน (polycrystalline) เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเรียงตัวของอะตอมเป็นลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่า n ที่เกิดการเลี้ยวเบนไปของรังสีเอกซ์เมื่อชนกับอะตอมของสาร เราจะทราบถึงระยะห่าง

๙
๔๐
๗๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๙



สำนักหอสมุด

25 七月 2559

ระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้น ๆ อีกด้วย การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิช c , a และค่าอัตราส่วน c/a สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องเอกซเรย์ดิฟเฟรนซ์ แลจากสมการที่ (11)

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (11)$$

ในระบบเทธรอโนนั้น ค่าแลตทิช a มีค่าเท่ากับแลตทิช b แต่ไม่เท่ากับแลตทิช c ($a = b \neq c$) ดังนั้น จากสมการที่ (11) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (12)$$

หรือ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = (h^2 + k^2) + \frac{l^2}{(c/a)^2} \quad (13)$$

สำหรับเดดไฟฟานาสามารถคำนวณหาค่าอัตราส่วน c/a ได้โดยนำค่า d-spacing d_{002} และ d_{200} มาคำนวณตามสมการ (14)

$$c/a = \frac{d_{002}}{d_{200}} \quad (14)$$

2.15 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบห้องแบบใช้แสงธรรมชาดและใช้รังสีแบบอื่น ๆ มีข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกออกจากจะขึ้นกับลักษณะของเลนส์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้อีกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังแยกขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน 2,000 เท่า จึงยังมองเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ว่าส่วนนั้นเป็นอะไร ต่อมาได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในกล้องจุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์กระจุก เรียกกล้องดังกล่าวว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบพื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อและวัตถุได้ โดยทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มของเงาแตกต่างกัน [33]

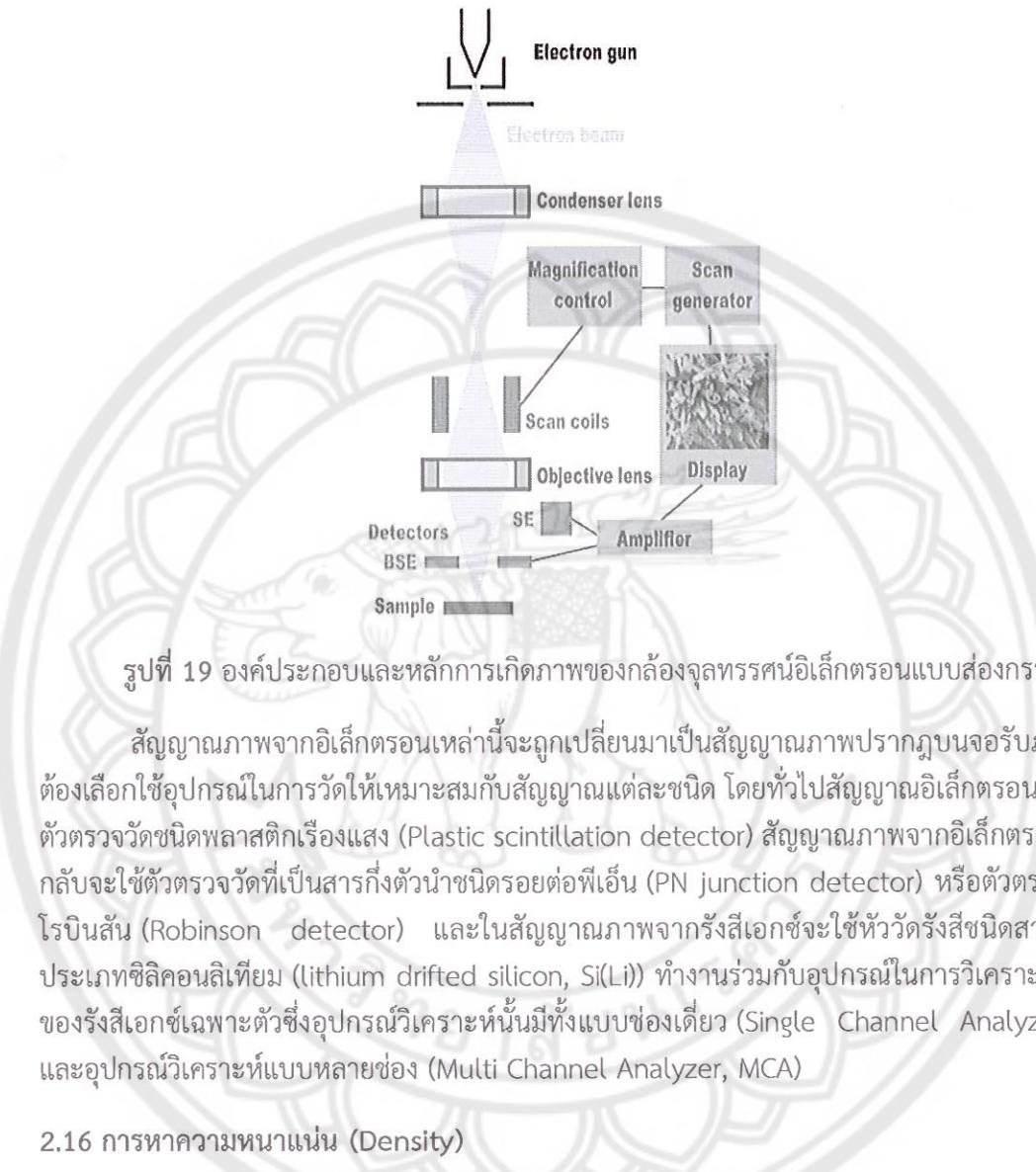
หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูง (1,000 ถึง 3,000 อิเล็กตรอนโวลท์ หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้ จากนั้นจึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสูญญากาศ 10^{-5} – 10^{-7} 托ร์ และมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นการเพิ่มความชัดของลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิงลงเบื้องล่างผ่านเลนส์ตัวตุ้น ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดไฟกับบนผิwtawoyangพอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตกกระทบผิwtawoyang หรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดขดลวดควบคุมการส่องกราด (scan coil) ของลำอิเล็กตรอน ทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิwtawoyang ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำอิเล็กตรอนกระทบผิwtawoyang จะเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมธาตุในตัวตุ้นหรือตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ขึ้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิด ต่าง ๆ ออกมานี้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะผิวของตัวอย่างและวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ

(1) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image, SEI) หรือเป็นอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลท์ เกิดที่พื้นผิwtawoyang ไม่เกิน 10 นาโนเมตร โดยเกิดกับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวยอิเล็กตรอนที่ผิwtawoyang

(2) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระแสเจิงกลับ (Backscattered Electron Image, BEI) หรือเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในขั้นงานเพียงบางส่วนและกระแสเจิงกลับออกมานี้มีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิwtawoyang ลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้กับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง

(3) สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับขั้นโคจรต่าง ๆ (K, L, M, \dots) ถูกกระตุ้น (excited) หรือได้รับพลังงานมากพอนอนหลุดออกจากวงโคจรออกมานี้ทำให้อะตอมต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างรวมภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากขั้นวงโคจรถัดไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกินออกมานี้ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับขั้นโคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ



รูปที่ 19 องค์ประกอบและหลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพประภาณจอรับภาพได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอนทุกตัวจะใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (Plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระแสจิงกัสบจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด半導體ต่อพีเจ็น (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (Robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์จะใช้หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเทกซิลิคอนลิตيوم (lithium drifted silicon, Si(Li)) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบช่องเดียว (Single Channel Analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (Multi Channel Analyzer, MCA)

2.16 การหาความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หน่วยของค่าความหนาแน่นสามารถเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร ,กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ,ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น สำหรับส่วนที่ได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเชรามิกอย่างยิ่งคือ การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการขัดแฉนตัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขีนรูป ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวนนั้นยังสามารถนำไปสู่การหาค่าความพรุนของวัสดุได้อีกด้วย

การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้นอาศัยหลักการของอาร์คิมีดีสที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อจุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของของแข็ง” วิธีการนี้ทำได้โดยการหาค่ามวลของวัตถุในอากาศและขณะที่จุ่มอยู่ในของเหลว

$$\text{ความหนาแน่น } \rho = \frac{W_a}{W_a - W_{fl}} \cdot \rho_{fl} \quad (15)$$

เมื่อ ρ คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ρ_{fl} คือ ค่าความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

W_a คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม

W_{fl} คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม

ส่วนการหาความหนาแน่นของของเหลวในกรณีที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของของแข็งลงไปสามารถหาได้จาก

$$\rho_{fl} = G / V \quad (16)$$

โดยที่ G คือ แรงพยุงที่เกิดขึ้นกับของแข็ง (หน่วยเป็นกรัม) หาได้จากน้ำหนักของชิ้นงานใน

ลบด้วยน้ำหนักของชิ้นงานในของของเหลว

V คือ ปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

สำหรับการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density): ρ_r] นั้น สามารถคำนวณหาได้ตามสมการที่ (17)

$$\rho_r (\%) = \left(\frac{\rho_b}{\rho_{th}} \right) \times 100 \quad (17)$$

เมื่อ ρ_r คือ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

ρ_b คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ρ_{th} คือ ค่าความหนาแน่นในทฤษฎีของสาร มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. บิสมัทออกไซด์ (Bi_2O_3) ความบริสุทธิ์ 99.5%
2. โซเดียมไนเตรต (NaNO_3) ความบริสุทธิ์ 99.5 %
3. โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K_2CO_3) ความบริสุทธิ์ 99.5 %
4. ลิเทียมคาร์บอเนต (Li_2CO_3) ความบริสุทธิ์ 99.5 %
5. ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ความบริสุทธิ์ 99.5 %
6. แอลานาลัมออกไซด์ (La_2O_3) ความบริสุทธิ์ 99.5 %
7. ไกลีซีน ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$)
8. สารละลายเอทานอล (Ethanol absolution) ความบริสุทธิ์ 99.7%

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสาร

1. เครื่องชั่งแบบละเอียด satorius AG GOTTINGEN type Fabr-Nr (ควบคุมการทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ชั่งมวลได้มากที่สุดไม่เกิน 310 กรัม โดยมีความละเอียด 0.001 กรัม
2. ตู้อบสารของยีห้อ Memmert D06057 Model 100 อุณหภูมิในการอบสูงสุด 200°C
3. กระปองพลาสติกที่ใช้ในการผสมสารทำด้วยโพลีเมอร์และมีฝ้าปิดสนิท โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ความสูง 10.7 เซนติเมตร
4. เม็ดดยอยทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร (ใช้จำนวน 250 เม็ด)
5. เครื่องผสมแบบบดดยอยแบบลูกบอล (Ball milling)
6. Hot plate สำหรับใช้ในการทำให้สารระเหยออก
7. Magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากัน
8. ข้อมตักสาร
9. บีกเกอร์ขนาด 250 ซีซี
10. บีกเกอร์ขนาด 1000 ซีซี
11. แม่พิมพ์ (Punch and die) ใช้ในการขีนรูปเซรามิก
12. กระดาษฟอยล์ (Foil)
13. เครื่องอัดไฮดรอลิกสำหรับขีนรูปเซรามิก อัดแรงดันได้สูงสุด 1000 Kg/cm^3
14. เตาเผาสาร

15. เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer)
16. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (SEM)

วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการเตรียมผงผลึกและเซรามิก BNKLLT มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 การเตรียมผงผลึก BNKLLT

1. ชั้งสารตั้งต้นคือ บิสมัทออกไซด์ (Bi_2O_3) โซเดียมคาร์บอเนต (NaNO_3) โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K_2CO_3) ลิเทียมคาร์บอเนต (Li_2CO_3) ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) และนาลัมออกไซด์ (La_2O_3) ซึ่งตามอัตราส่วนโดยมวลที่ได้จากการคำนวณ
2. นำสารที่ผ่านการซึ่งจากข้อ 1 มาทำการผสมตามนิยดของผงผลึกที่ต้องการในกระป๋องพลาสติกที่มีเม็ดบลอกขนาด 7 มิลลิเมตร จำนวน 300 เม็ด โดยเติมເອຫານอลในปริมาณ 250 มิลลิลิตร ซึ่งจะช่วยในการผสมสารให้ผสมกันดียิ่งขึ้น โดยจะมีกระป้องผสมสาร จากนั้นนำไปบดอย่างบันเครื่องบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
3. มีครับ 24 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป๋องบลอกแต่ละกระป๋องทำการเทลงในตะแกรง漉ที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อแยกของที่ผสมออกจากเม็ดบลอก และวึงทำการแยกເອຫານอล ออกโดยใช้ Hot plate
4. เมื่อทำการแยกເອຫານอลออกจากสารแล้วจึงทำการอบในเตาอบโดยใช้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
5. นำสาร BNKLLT ที่ผ่านการอบแห้งแล้วมาทำการบดอย่างหยาบโดยใช้ครกหยก (Agate) เพื่อคัดขนาดและเพื่อให้ได้ผงผลึกที่มีขนาดที่สม่ำเสมอ
6. นำผงผลึกที่ผ่านการบดคัดขนาดในแต่ละชนิดมาบดผสมไกลซีน โดยใช้อัตราส่วน สารตั้งต้น : เชือเพลิง (ไกลซีน) เป็น 1:0.56 กรัม นำสารที่บดผสมไกลซีนมาใส่ใน Crucible เปิดฝาจากนั้นนำไปเผาแคลไชน์ในเตาโดยใช้อุณหภูมิ 600-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
7. นำผงผลึก BNKLLT ที่ผ่านการแคลไชน์ไปตรวจสอบโครงสร้างผงผลึกและโครงสร้างจุลภาค ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด

ตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก BNKLLT

1. ทำการเตรียมเซรามิก BNKLLT โดยการนำผงผลึก BNKLLT ที่ได้จากการเผาแคลไชน์จากตอนที่ 1 มาใส่กระป๋องพลาสติกที่มีเม็ดบลอกขนาด 7 มิลลิเมตร โดยเติมເອຫານอลในปริมาณ 200 มิลลิลิตร และ

ผสม PVA ลงไปเป็นปริมาณร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก จากนั้นทำการปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปบดโดยอยบนเครื่องบดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

2. เมื่อครบ 12 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป่องบดเหล็กในตะแกรง漉ท์ที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อแยกของที่ผสมออกจากเม็ดบด ทำการแยกเอาอุทานอลออกโดยใช้ Hot plate และนำไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

3. นำสารที่อ่อนเสร็จในแต่ละชนิดมาบดโดยอย่างหยาบโดยใช้ครกหยก (Agate) เพื่อคัดขนาดเพื่อให้ได้ผงผลึกที่มีขนาดที่สม่ำเสมอ

4. จากนั้นนำผงผลึก BNKLLT ที่ผสม PVA และผ่านการบดโดยคัดขนาด มาทำการอัดขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงกระบอกโดยใช้แม่พิมพ์โลหะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยใช้ผงผลึก BNKLT ในปริมาณ 1.5 กรัม โดยใช้ค่าความดันในการอัดขึ้นรูป 80 MPa ในการอัดขึ้นรูป 1 ครั้ง

5. นำขั้นงานแต่ละชนิดที่ผ่านการขึ้นรูปมาเรียงไว้ในถ้วยอะลูมีนาที่มีฝาปิด โดยทำไส่อะลูมีนาด้านล่าง แล้วจึงวางขั้นงานจากนั้นจะนำผงอะลูมีนา kab ทับอีกครั้ง ทำการเผาชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075-1150 องศาเซลเซียสโดยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

6. นำเซรามิก BNKLLT ที่ผ่านการเผาชิ้นเตอร์ไปทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้า

บิสมัทออกไซด์ (Bi_2O_3) + โซเดียมคาร์บอเนต (NaNO_3) + โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K_2CO_3)
ลิเทียมคาร์บอเนต (Li_2CO_3) + ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) + แลนทาลัมออกไซด์ (La_2O_3)



บดย่อยแบบลูกบล็อกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง



ทำให้แห้งและคัดขนาด



ผสมผงผลึก uncalcined กับไกลซีน ในอัตราส่วน 1 : 0.56



เผาแคคลายเซนท์ที่อุณหภูมิ 600 – 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



นำไปวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ (XRD)

และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนแบบส่องกราด (SEM)

รูปที่ 20 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก BNKLLT

ผงพลีก BNKLT บด ผสม PVA 12 ชั่วโมง



ทำให้แห้งและคัดขนาด



ทำการขึ้นรูปโดยใช้ความดัน 80 MPa



เผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075 – 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



นำไปเคราะห์โครงสร้างพลีก โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้า

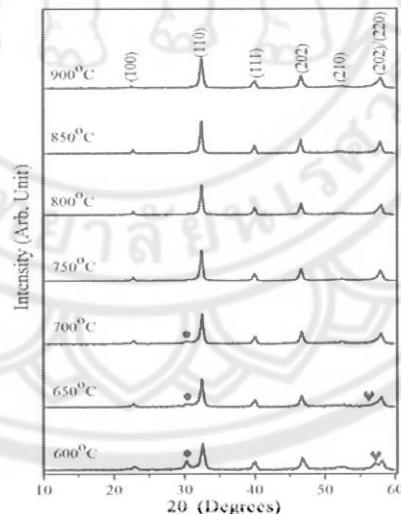
รูปที่ 21 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก BNKLLT

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

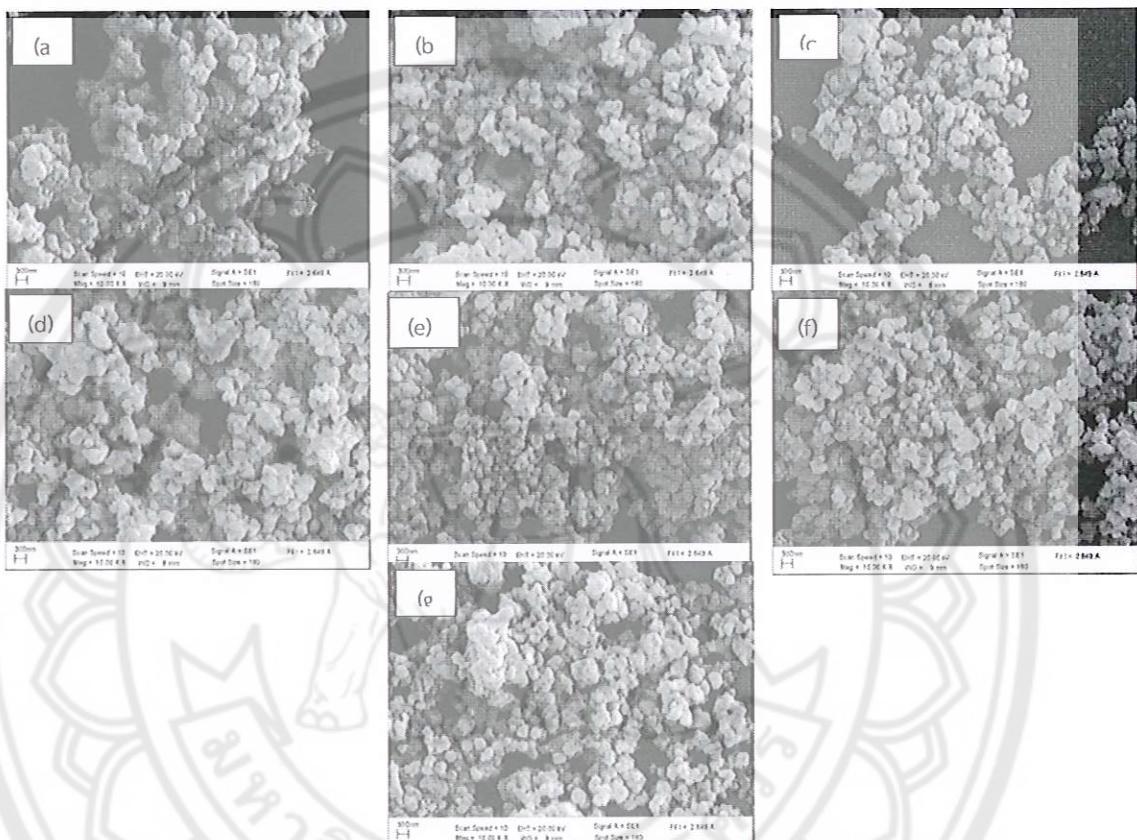
4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer : XRD) ของผลึกบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมมิเทียมแทนทาลัมไทด์นาโน

รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึก $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.68}\text{K}_{0.22}\text{Li}_{0.1})_{0.5}\text{TiO}_3$ ที่เจือ La_2O_3 ปริมาณ 0.1 wt.% (BNKLLT) เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่ โดยใช้ไกลจีนเป็นเชื้อเพลิง ในอัตราส่วน 1 : 0.56 และใช้อุณหภูมิในการแคลไชน์ระหว่าง 600 – 900 องศาเซลเซียส อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที แสดงในรูปที่ 22 จะเห็นว่าผลึก BNKLLT แสดงโครงสร้างเฟสแบบรวมโบ埃ดรัลในทุกตัวอย่าง ซึ่งสัมพันธ์กับเพิ่มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS 36 – 0340 เมื่ออุณหภูมิแคลไชน์ต่ำกว่า 750 องศาเซลเซียส พบรีศักดิ์กลอมเกิดขึ้น ในขณะที่ค่าร้อยละความบริสุทธิ์ของเซรามิก BNKLLT มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไชน์สูงขึ้นดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่ออุณหภูมิแคลไชน์เป็น 750 องศาเซลเซียส ผลึก BNKLLT มีค่าความบริสุทธิ์เป็นร้อยละ 100 ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการแคลไชน์นี้ต่ำกว่าวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็ง [11] 100 องศาเซลเซียส



รูปที่ 22 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึก BNKLLT แคลไชน์ระหว่าง 600 – 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที โดยที่ (●) คือ TiO_2 และ (♥) คือ La_2O_3

4.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของของผงพลาสติกบีสมัทโพแทสเซียมคลีเทียมแทนทาลัมไททาเนตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope)



รูปที่ 23 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของผงพลาสติก BNKLLT แคลไชน์ที่อุณหภูมิ (a) 600, (b) 650, (c) 700, (d) 750, (e) 800, (f) 850 และ (g) 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

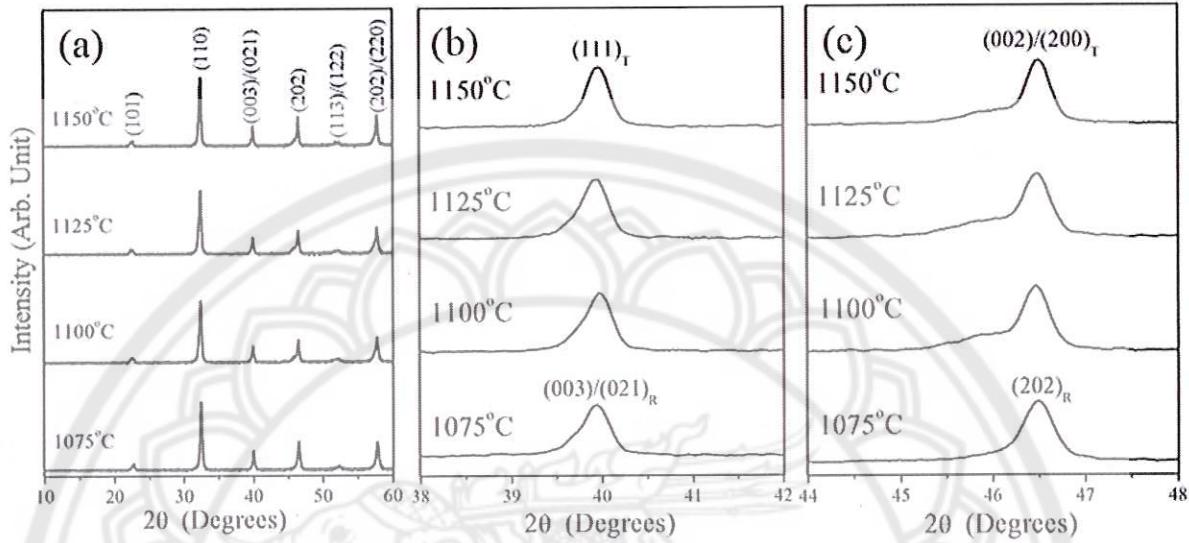
จากการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของผงพลาสติก BNKLLT ที่แคลไชน์ระหว่าง 600-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 23 พบว่า อนุภาคของผงพลาสติก BNKLLT มีลักษณะค่อนข้างกลม เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่น และขนาดของอนุภาค การกระจายตัวต่ำ โดยอนุภาคของผงพลาสติกมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไชน์เพิ่มขึ้น และมีขนาดอนุภาค เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 172 – 258 นาโนเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ร้อยละความบริสุทธิ์และขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงพลีก BNKLLT แคลไชน์ที่อุณหภูมิระหว่าง 600 – 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิแคลไชน์ (°C)	ร้อยละความบริสุทธิ์	ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (nm)
600	93.7	172
650	96.9	184
700	99.5	198
750	100	224
800	100	231
850	100	243
900	100	258

4.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างพลีกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer : XRD) ของเซรามิกปิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมลิเทียมแทนทalaumai ท่าเนต

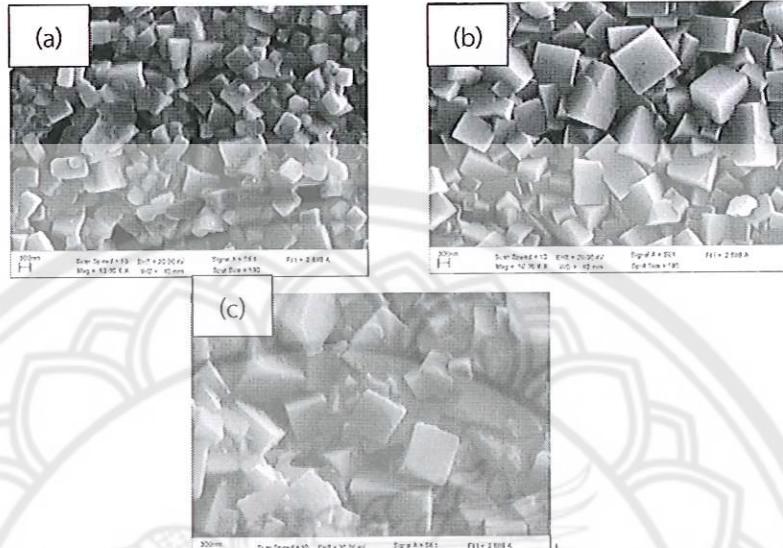
นำผงพลีก BNKLLT ที่แคลไชน์ที่ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาอัดขึ้นรูปเป็นเม็ด และเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1075 – 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วนำเม็ดเซรามิกที่ผ่านการซินเตอร์มาตรวจสอบโครงสร้างพลีกของเซรามิก BNKLLT ด้วยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าเซรามิก BNKLLT แสดงโครงสร้างเฟสเดียวเพอร์อฟสไกร์ท์ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 24 พบเฟสเดียวของรอมโบไฮดรัลในตัวอย่างของเซรามิกที่มีอุณหภูมิชินเตอร์เป็น 1075 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นสังเกตได้ว่าพีคคู่ $(003)/(021)_R$ เริ่มรวมกันเป็นพีคเดียว $(111)_T$ ที่มุม $\sim 40^\circ$ ขณะที่พีคเดียว $(202)_R$ เริ่มแยกออกเป็นพีคคู่ $(002)/(200)_T$ ที่มุม $\sim 46.5^\circ$ (รูปที่ 24 (b),(c)) แสดงให้เห็นว่าความเป็นเทธระโภนัลเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงขึ้น [11]



รูปที่ 24 รูปแบบการเลี้ยงบนรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNKLLT ที่ชินเตอร์ระหว่าง 1075 – 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

4.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของของเซรามิกบิสมัทโดยเดี่ยมโพแทสเซียมลิเทียมแทนท้าล์ไมทานเคน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope)

จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก BNKLLT ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075 – 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าเกรนเซรามิก BNKLLT มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม ที่อุณหภูมิชินเตอร์ต่ำ (1075 องศาเซลเซียส) เซรามิกมีรูพรุนค่อนข้างมาก (รูปที่ 25 (a)) เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงขึ้นจนถึง 1100 องศาเซลเซียส ปริมาณของรูพรุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการผนึกตัวมากขึ้น ขอบเกรนเห็นได้ชัดเจน (รูปที่ 25 (b)) ที่อุณหภูมิชินเตอร์สูงกว่า 1100 องศาเซลเซียส พบร่องของเกรนของเซรามิกเริ่มไม่ชัดเจนและมีการหลอมรวมกันของเกรน (รูปที่ 25 (c)) เกรนของเซรามิก BNKLLT มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นโดยขนาดเกรนเฉลี่ยแสดงดังตารางที่ 2



รูปที่ 25 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก BNKLLT ชนเทอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1075, (b) 1100 และ (c) 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ เป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

ตารางที่ 2 ร้อยละความบริสุทธิ์และขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก BNKLLT ชนเทอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1075 – 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิชนเทอร์ (°C)	ร้อยละความบริสุทธิ์	ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)
1075	100	0.82
1100	100	1.12
1125	100	1.31
1150	100	1.48

4.5

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเซรามิก BNKLLT

เมื่อทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น และร้อยละการหดตัวเชิงปริมาตร ของเซรามิก BNKLLT ชนเทอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ พบร้าค่าความหนาแน่น และร้อยละการหดตัวของเซรามิก BNKLLT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการซินเทอร์เพิ่มขึ้น จนถึงอุณหภูมิชนเทอร์ 1100 องศาเซลเซียส เซรามิกมีค่าความหนาแน่นและร้อยละการหดตัวสูงสุดเป็น 5.73 และ 20.3 ตามลำดับ เมื่อ

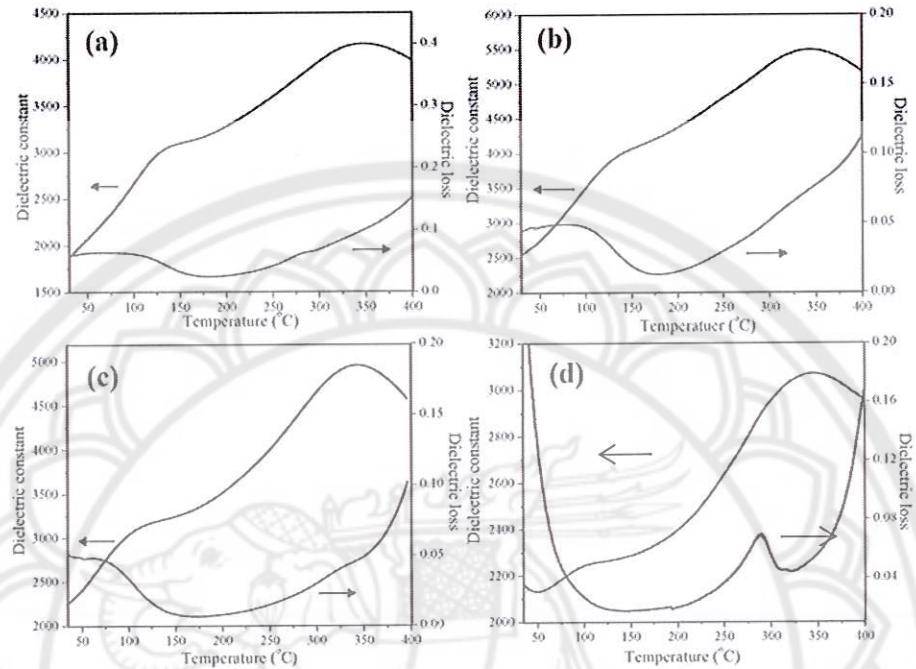
อุณหภูมิชินเตอร์สูงกว่า 1100 องศาเซลเซียส เซรามิกมีค่าความหนาแน่นและร้อยละการหดตัวลดลงเนื่องมาจากการระเหยของสารตั้งต้นบางชนิด ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าความหนาแน่นและร้อยละการหดตัวของเซรามิก BNKLLT ชินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิชินเตอร์ (°C)	ค่าความหนาแน่น (g/cm ³)	ร้อยละการหดตัว (%)
1075	5.68	19.2
1100	5.73	20.3
1125	5.61	18.6
1150	5.54	15.1

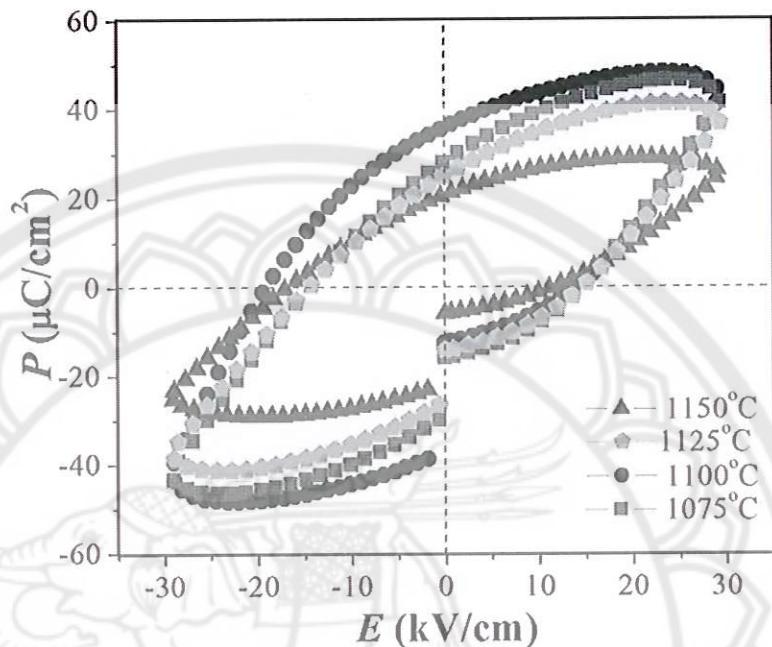
4.6 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLLT

ผลจากการวิเคราะห์สมบัติโดยอิเล็กทริกของเซรามิก BNKLLT ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้ความถี่เป็น 1 kHz ในการวัด และแสดงในรูปที่ 26 พบว่าเกิดพื้นที่ส่องพื้นในทุกตัวอย่าง โดยพื้นแรกแสดงที่อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเปลี่ยนเฟส (T_d) จากเฟอร์โรอิเล็กทริกไปเป็นแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริก และพื้นที่สองเป็นการเปลี่ยนเฟสจากแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริกไปเป็นพาราอิเล็กทริกซึ่งเรียกอุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟสนี้ว่าอุณหภูมิคูรี (T_c) จะเห็นได้ว่า T_d สูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิชินเตอร์จนถึง 1100 องศาเซลเซียส จากนั้นมีค่าลดลง ขณะที่ T_c ลดลง เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 4 โดย N.W. Thomas ได้เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสจากเฟอร์โรอิเล็กทริกไปเป็นแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริก (ที่อุณหภูมิ T_d) ของวัสดุ เฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบเพอร์อฟสไกต์ขึ้นอยู่กับความเสถียรของโดเมนในวัสดุ [26] ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกสูงสุด (c_m) พบที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส และค่าคงที่ได้อิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง (c_e) มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1075 ถึง 1100 องศาเซลเซียส จากนั้นเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงกว่า 1100 องศาเซลเซียส ค่าการสูญเสียได้อิเล็กทริก ($\tan\delta$) ที่อุณหภูมิห้อง (T_r) มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิชินเตอร์ถึง 1100 องศาเซลเซียส จากนั้นเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงกว่า 1100 องศาเซลเซียส ค่าการสูญเสียได้อิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรี มีค่าอยู่ระหว่าง 0.051 – 0.085 แสดงในตารางที่ 4 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิชินเตอร์ไม่ส่งผลต่อค่าการสูญเสียได้อิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรี



รูปที่ 26 สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNKLLT ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างกันโดย (a) 1075°C , (b) 1100°C , (c) 1125°C และ (d) 1150°C

วงวนยีสเทอเรชิส (P-E loops) ของเซรามิก BNKLLT ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ ตรวจวัดที่อุณหภูมิห้องแสดงในรูปที่ 27 ลักษณะของวงวนยีสเทอเรชิสไม่เปลี่ยนตัวในทุกตัวอย่างซึ่งแสดงถึงผลการทดลองในงานวิจัยก่อนหน้านี้ ซึ่งค่าสภาพขั้วคงค้าง (P_r) และค่าสนามลบล้าง (E_c) เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก $1075 - 1100$ องศาเซลเซียส จากนั้นลดลงเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงกว่า 1100°C เนื่องมาจากตัวอย่างมีความหนาแน่นต่ำและมีรูพรุนเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นและการลดลงของ P_r และ T_d มีแนวโน้มที่เหมือนกัน ซึ่งค่าทั้งสองเกี่ยวข้องกับความเสถียรของโดเมนในวัสดุเฟริโออิเล็กทริก ค่าคงที่ไฟอิโซอิเล็กทริก (d_{33}) ของเซรามิก BNKLLT ที่อุณหภูมิต่างๆ แสดงในตารางที่ 4 พบร้าค่าเพิ่มขึ้นจาก 132 ถึง 210 pC/N เมื่อเพิ่มอุณหภูมิซินเตอร์จาก 1075 ถึง 1100 องศาเซลเซียส ต่อมากลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิซินเตอร์จาก 1125 ถึง 1150 องศาเซลเซียส ซึ่งเซรามิกที่ใช้อุณหภูมิในการซินเตอร์เป็น 1100 องศาเซลเซียส มีค่า d_{33} มากที่สุดเป็น 210 pC/N



รูปที่

27 ๓

วนอีสเทอร์ซิสของเซรามิก BNKLLT ชินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ

ตารางที่ 4 แสดงอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLLT

อุณหภูมิ ชินเตอร์ (°C)	อุณหภูมิการ เปลี่ยนเฟส (°C)	ε_r	$\tan\delta$ ที่ T_r	ε_m	$\tan\delta$ ที่ T_c	P_r ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	E_c (kV/cm)	d_{33} (pC/N)
		T_d	T_c					
1075	131	341	1986	0.065	4237	0.085	28.98	18.72
1100	134	338	2572	0.042	5536	0.071	35.78	22.42
1125	127	335	2140	0.053	4985	0.051	26.76	18.54
1150	113	332	1947	0.272	3155	0.057	17.24	145

ดังนั้นในงานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์ผงผลึก BNKLLT ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคน้อยด้วยวิธีการเผาใหม่ และสามารถสังเคราะห์เซรามิก BNKLLT ที่มีความหนาแน่นสูง สมบัติไดอเล็กทริก ($\epsilon_r \cong 2572$ และ $\epsilon_m \cong 5536$) สมบัติเฟร่ออิเล็กทริก ($P_r \cong 35.78 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ และ $E_c \cong 22.42 \text{ kV/cm}$) และค่าคงที่เพอไซอิเล็กทริกที่ดี ($d_{33} \cong 210 \text{ pC/N}$) เมื่อเทียบกับเซรามิกที่สังเคราะห์ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ดังนั้นวิธีการเผาใหม่จะเป็นทางเลือกใหม่ในการประดิษฐ์เซรามิกเพื่อใช้เล็กทริกในสารต่างๆ



บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลการทดลองการเตรียมเซรามิก BNKLLT

เตรียมเซรามิก BNKLLT ด้วยวิธีการเผาใหม่ โดยใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิง แคลไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 – 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที พบว่า ผงผลึก BNKLLT มีโครงสร้างเฟสแบบรอมโบฮีดรัล ผงผลึกที่บริสุทธิ์สามารถเตรียมได้โดยใช้เงื่อนไขการ แคลไนซ์ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็ง 100 องศาเซลเซียส และพบว่าอนุภาคของผงผลึก BNKLLT มีลักษณะค่อนข้างกลมและเกาะกลุ่มกันอย่าง หนาแน่น อนุภาคของผงผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไนซ์เพิ่มขึ้น สำหรับเซรามิก BNKLLT แสดง เฟสเดียวแบบรอมโบฮีดรัลในตัวอย่างที่ซินเตอร์ 1075 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นสังเกต ได้ว่าความเป็นเทหะระgon ของโครงสร้างเฟสเพิ่มขึ้น เซรามิกที่เตรียมภายใต้เงื่อนไขการซินเตอร์ที่ อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีค่าความหนาแน่นสูง (5.73 g/cm^3) กว่าวิธีปฏิกริยาสถานะ ของแข็ง (5.67 g/cm^3) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง ($\varepsilon_{\infty} \cong 5536$) ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกต่ำ ($\tan \delta \cong 0.071$) สมบัติเพอร์โටอิเล็กทริกที่ดี ($P_r \cong 35.78 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ และ $E_c \cong 22.42 \text{ kV}/\text{cm}$) และค่าคงที่ไฟอิ โโซอิเล็กทริกที่สูง ($d_{33} \cong 210 \text{ pC/N}$) จากผลการทดลองพบว่าโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ และ สมบัติทางไฟฟ้า มีความสอดคล้องซึ้งกันและกัน แสดงว่าให้เห็นว่าวิธีการเผาใหม่เป็นวิธีการที่มีความ สะดวก ประหยัดพลังงานและทำให้ได้เซรามิก BNKLLT ที่มีคุณภาพสูง

បររណ្ឌកម្ម

- [1] G.A. Smolenskii, V.A. Isupov, A.I. Agranovskaya and N.N. Krainik, New ferroelectrics of complex composition. Sov. Phys. Solid State 2 (11) (1961) 2651-2654.
- [2] B. Jaffe, W.R. Cook and H. Jaffe, Piezoelectric ceramics. Academic Press, New York, (1971).
- [3] Z. Yang, X. Chao and L. Yang, Jpn. Effect of sintering process on characteristics of multilayer piezoelectric $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ ceramic transformers. J. Appl. Phys. 46(10A) (2007) 6746-6750.
- [4] Y. Li, W. Chen, J. Zhou, Q. Xu, H. Sun and M. Liao, Dielectric and ferroelectric properties of lead-free $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3-\text{K}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$ ferroelectric ceramics. Ceram. Int. 31 (2005) 139-142.
- [5] M. Chen, Q. Xu, B.H. Kim, B.K. Ahn, J.H. Ko, W.J. Kang, O.J. Nam, Structure and electrical properties of $(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})_{1-x}\text{Ba}_x\text{TiO}_3$ piezoelectric ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 28 (2008) 843-849.
- [6] S.T. Zhang, A.B. Kounga, E. Aulbach, T. Granzow, W. Jo, H.J. Kleebe and J. Rödel, Lead-free piezoceramics with giant strain in the system $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3-\text{BaTiO}_3-\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{NbO}_3$. I. Structure and room temperature properties. J. Appl. Phys. 103 (2008) 034107.
- [7] Z.P. Yang, Y.T. Hou, H. Pan and Y.F. Chang, Structure, microstructure and electrical properties of $(1-x-y)\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3-x\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{TiO}_3-y\text{Bi}_{0.5}\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_3$ lead-free piezoelectric ceramics. J. Alloys Compd. 480 (2009) 246-253.
- [8] C.R. Zhou, X.Y. Liu, W.Z. Li, C.L. Yuan and G.H. Chen, Structure and electrical properties of $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}, \text{K})_{0.5}\text{TiO}_3-\text{BiGaO}_3$ lead-free piezoelectric ceramics. Curr. Appl. Phys. 10 (2010) 93-98.
- [9] H. Yu and Z.G. Ye, Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of the lead-Free $(1-x)(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3-x\text{BiAlO}_3$ solid solution. Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 112902.
- [10] A. Herabut and A. Safari, Processing and electromechanical properties of $(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})_{(1-1.5x)}\text{La}_x\text{TiO}_3$ ceramics. J. Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 2954-2958
- [11] H. Pan, Y. Hou, X. Chao, L. Wei and Z. Yang, Microstructure and electrical properties of La_2O_3 -doped $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.68}\text{K}_{0.22}\text{Li}_{0.1})_{0.5}\text{TiO}_3$ lead-free piezoelectric ceramics. Curr. App. Phy.11 (2011) 888-892.
- [12] A. Thongtha and T. Bongkarn, Phase formation and microstructure of barium

- zirconate ceramics prepared using the combustion technique. *Ferroelectrics.* 383 (2009) 33-39.
- [13] P. Panya, N. Vittayakorn, N. Phungjitt and T. Bongkarn, The structural phase and microstructure of perovskite $Ba(Ti_{1-x}Zr_x)O_3$ ceramics using the combustion Route. *Func. Mater. Lett.*, 2(4) (2009) 169-174.
- [14] P. Julphunthong and T. Bongkarn, Phase formation, microstructure and dielectric properties of $Ba(Zr_{0.1}Ti_{0.9})O_3$ ceramics prepared via the combustion technique. *Curr. Appl. Phys.* 11(3) (2011) 60-65.
- [15] G. A. Smolenskii and A. I. Agranovuskaya, Dielectric polarization of a number of complex compounds. *Sov. Phys. Solid State.* 1, (1959) 14297.
- [16] L. E. Cross, Relaxor ferroelectrics. *Ferroelectrics.* 76 (1987) 241.
- [17] T. Comyn, The role of employers in the development of employability skills in novice workers. Doctoral dissertation, Ph.D., University of Leeds, U. K. (1998).
- [18] Y. H. Chen, K. Uchino, and D. Viehland, Substituent effects in $0.65Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $0.35PbTiO_3$ piezoelectric ceramics. *J. Electroceram.* 6(1) 13 (2001).
- [19] B.W.R.H. Jaffe, Cook, and Jaffe, Piezoelectric ceramics. London: Academic Press (1971).
- [20] G.H Haertling, Ferroelectric ceramics : History and Technology, *J. Am. Ceram. Soc.*, 82 (1999) 797-818.
- [21] L. Ruan, L. Li and Z. Gui, Temperature stable dielectric properties for $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $BaTiO_3$ - $PbTiO_3$ system ceramics, *J. Mats. Lett.*, 16 (1997) 1020-1022.
- [22] A. J. Moulson and J. M. Herbert, Electroceramics: Materials, Properties and Application. 1st ed, Chapman and Hall (1990).
- [23] H. David and R. Robert, Physics, past 2. 1st ed, John Wiley & Sons (1962).
- [24] B. Tareev, Physics of dielectric materials. 2nd ed, Mir Publishers (1979).
- [25] อโนชา หมั่นภักดี, โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไดอเล็กทริกของเลดแมกนีเซียมไนโตรบেตที่เตรียมจากสารตั้งต้นเลดเมต้าไนโตรบีตและเลดแมกนีเซียมออกไซด์ (2544).
- [26] S. Ananta and N. W. Thomas, Relationships between Sintering Conditions, Microstructure and Dielectric Properties of Lead Magnesium Niobate, *J. Eur. Ceram. Soc.* 19 (1999) 629-635.
- [27] S. L. Swartz, T. R. Shrout, W. A. Schulze and L. E. Cross, Dielectric properties of lead-magnesium niobate ceramics, *J. Am. Ceram. Soc.* 67 (1984) 311-315.
- [28] P. Papet, J. P. Dougherty and T. R. Shrout, Particle and grain size effects on the dielectric behavior of the relaxor ferroelectric $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$, *J. Mater. Res.* 5(12)

(1990) 2902-2909.

- [29] T. R. Shroud, Z. P. Chang, N. Kim, and S. Markgraf, Dielectric behavior of single crystals near the $(1-x)\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-x\text{PbTiO}_3$ morphotrophic phase boundary. *Ferroelectrics lett.* 12(63) (1990).
- [30] Reed, J.S. *Introduction to the principles of ceramic processing*, New York: Wiley (1996).
- [31] Hart, L.D., Hudson, L.K. *American ceramic society bulletin*, 43:13 (1994).
- [32] สุรินทร์ ลิ่มปนาท และครูไนน์ ขุนทด. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรากชัน, เครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎี และการทำงานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) (หน้า 309-322).
- [33] กฤษณ์ ศิวเลิศกมล. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุรังสีเอกซ์, เครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) (หน้า 289-305).